



Docket No.: 21776-00044-US
(PATENT)

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Takahisa Nitta et al.

Application No.: 09/436,637

Confirmation No.: 6921

Filed: November 9, 1999

Art Unit: 1723

For: CHEMICAL SUPPLY SYSTEM

Examiner: C. E. Cooley

CLAIM FOR PRIORITY AND SUBMISSION OF DOCUMENTS

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 U.S.C. 119 based on the following prior foreign applications filed in the following foreign countries on the dates indicated:

<u>Country</u>	<u>Application No.</u>	<u>Date</u>
Japan	10-319035	November 10, 1998
Japan	11-007063	January 13, 1999
Japan	11-316244	November 8, 1999

In support of this claim, a certified copy of each said original foreign application is filed herewith.

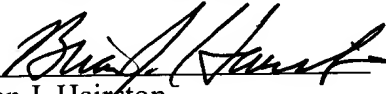
Application No.: 09/436,637

Docket No.: 21776-00044-US

Applicant believes no fee is due with this response. However, if a fee is due, please charge our Deposit Account No. 22-0185, under Order No. 21776-00044-US from which the undersigned is authorized to draw.

Dated: March 31, 2004

Respectfully submitted,

By 
Brian J. Hairston

Registration No.: 46,750
CONNOLLY BOVE LODGE & HUTZ LLP
1990 M Street, N.W., Suite 800
Washington, DC 20036-3425
(202) 331-7111
(202) 293-6229 (Fax)
Attorney for Applicant

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 1 9 9 8 年 1 1 月 1 0 日
Date of Application:

出 願 番 号 平成 1 0 年 特 許 願 第 3 1 9 0 3 5 号
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 1 9 9 8 - 3 1 9 0 3 5]

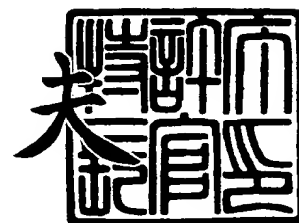
出 願 人 ユーシーティー株式会社
Applicant(s):



2 0 0 4 年 2 月 2 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 UCRI003

【提出日】 平成10年11月10日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 21/00
F04B 9/00

【発明の名称】 薬液供給ポンプ、薬液供給装置、薬液供給システム、基板洗浄装置、薬液供給方法、及び基板洗浄方法

【請求項の数】 37

【発明者】

【住所又は居所】 東京都文京区本郷4丁目1番4号 株式会社ウルトラクリーンテクノロジー開発研究所内

【氏名】 三木 正博

【発明者】

【住所又は居所】 東京都文京区本郷4丁目1番4号 株式会社ウルトラクリーンテクノロジー開発研究所内

【氏名】 新田 雄久

【発明者】

【住所又は居所】 東京都文京区本郷4丁目1番4号 株式会社ウルトラクリーンテクノロジー開発研究所内

【氏名】 山口 嘉昭

【特許出願人】

【識別番号】 596089517

【氏名又は名称】 株式会社ウルトラクリーンテクノロジー開発研究所

【代理人】

【識別番号】 100090273

【弁理士】

【氏名又は名称】 國分 孝悦

【電話番号】 03-3590-8901

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 035493

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9814281

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 薬液供給ポンプ、薬液供給装置、薬液供給システム、基板洗浄装置、薬液供給方法、及び基板洗浄方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 所定薬液を通過させる流路が形成され、前記流路の流入口に前記薬液の圧力上昇により閉じる吸引弁が、前記流路の流出口に前記薬液の圧力下降により閉じる吐出弁がそれぞれ設けられてなる薬液供給ポンプであって、

前記流路における接液面の少なくとも一部が前記薬液に対する不透過性且つ高耐蝕性の緻密部材からなるとともに、前記緻密部材の一部が可動壁とされており、

前記可動壁と連結する加振器を備え、前記加振器の駆動により前記可動壁をその壁面とはほぼ直交する方向に振動させて前記流路の体積を周期的に変化させることを特徴とする薬液供給ポンプ。

【請求項 2】 前記緻密部材は、導電性のものであることを特徴とする請求項 1 に記載の薬液供給ポンプ。

【請求項 3】 導電性の前記緻密部材は、アモルファスカーボンからなることを特徴とする請求項 2 に記載の薬液供給ポンプ。

【請求項 4】 前記可動壁と前記加振器との間に、前記加振器からの振動を前記可動壁へ伝達する駆動伝達手段を備えることを特徴とする請求項 1～3 のいずれか 1 項に記載の薬液供給ポンプ。

【請求項 5】 前記駆動伝達手段を弾発付勢する弾性手段を備えることを特徴とする請求項 4 に記載の薬液供給ポンプ。

【請求項 6】 前記加振器は圧電変換により前記可動壁を振動させる圧電振動子であることを特徴とする請求項 4 又は 5 に記載の薬液供給ポンプ。

【請求項 7】 前記可動壁と対向する前記接液面の少なくとも一部を構成する対向壁を導電性の前記緻密部材とし、

前記流路を通過する前記薬液を誘電体として挟持する前記可動壁と前記対向壁により形成されるキャパシタの静電容量を計測することを特徴とする請求項 2～6 のいずれか 1 項に記載の薬液供給ポンプ。

【請求項 8】 前記可動壁は、中心から周縁へ向かうにつれて厚くなる形状とされていることを特徴とする請求項 1～7 のいずれか 1 項に記載の薬液供給ポンプ。

【請求項 9】 前記可動壁と前記駆動伝達手段との間に、前記駆動伝達手段からの圧力を前記可動壁に均一に伝達する補助部材が設けられていることを特徴とする請求項 4～8 のいずれか 1 項に記載の薬液供給ポンプ。

【請求項 10】 前記駆動伝達手段は、前記可動壁に対する直接的な振動伝達部位を押圧した際に前記薬液から受ける反作用を見込んで、前記振動伝達部位及び前記反作用の大きい部位が厚く形成されていることを特徴とする請求項 4～9 のいずれか 1 項に記載の薬液供給ポンプ。

【請求項 11】 前記流路の接液部で前記薬液が溜まり易い隅部位及び前記薬液に対する低耐蝕性部位を通るようにガス通気系が設けられており、前記ガス通気系に所定ガスを通気させることを特徴とする請求項 1～9 のいずれか 1 項に記載の薬液供給ポンプ。

【請求項 12】 前記隅部位及び前記低耐蝕性部位は、少なくとも前記吸引弁、前記吐出弁及び前記可動壁の各々の周縁を含むことを特徴とする請求項 10 に記載の薬液供給ポンプ。

【請求項 13】 請求項 1～12 のいずれか 1 項に記載の薬液供給ポンプと、

前記薬液が混合する溶媒の通路である供給流路と前記薬液供給ポンプとを連結する連結流路とを備え、

前記連結流路内に前記供給流路と直接連結する細管部材が設けられており、

前記薬液供給ポンプの駆動により、前記細管部材から前記供給流路を通過する前記溶媒内に前記薬液を吐出し、所望濃度の混合溶液を調合することを特徴とする薬液供給装置。

【請求項 14】 前記薬液の吐出方向は前記溶媒の流動方向とほぼ直交する方向であり、

前記薬液供給ポンプは、前記細管部材から吐出する前記薬液の線速度が前記供給流路を通過する前記溶媒の線速度より大きくなるような押圧を前記薬液に与え

ることを特徴とする請求項 13 に記載の薬液供給装置。

【請求項 15】 前記連結流路の一部を囲む電極が設けられ、前記電極により前記連結流路を通過する前記薬液の静電容量を計測することを特徴とする請求項 13 又は 14 に記載の薬液供給装置。

【請求項 16】 前記細管部材の近傍における前記連結流路の一部を囲む薬液吐出停止手段を備え、

前記薬液供給ポンプの停止に同期して、前記細管部材から前記供給流路内の前記溶媒を若干量吸引することを特徴とする請求項 13～15 のいずれか 1 項に記載の薬液供給装置。

【請求項 17】 前記薬液吐出停止手段は、前記薬液を所定温度に加熱する電熱機構を有しており、前記薬液供給ポンプの停止に同期して前記電熱機構による加熱を停止することを特徴とする請求項 16 に記載の薬液供給装置。

【請求項 18】 前記薬液吐出停止手段は、圧搾機構を有しており、前記薬液供給ポンプの停止に同期して駆動することを特徴とする請求項 16 に記載の薬液供給装置。

【請求項 19】 前記細管部材は、前記薬液を所定温度に加熱する電熱機構を有しており、前記薬液供給ポンプの停止に同期して前記電熱機構による加熱を停止して、前記供給流路内の前記溶媒を若干量吸引することを特徴とする請求項 13～15 のいずれか 1 項に記載の薬液供給装置。

【請求項 20】 前記細管部材の前記供給流路との連結部位近傍に一对の温度検出素子を埋め込み、

前記薬液供給ポンプに同期して前記各温度検出素子の温度差を検出し、前記混合溶液の流動状態をモニターすることを特徴とする請求項 13～19 のいずれか 1 項に記載の薬液供給装置。

【請求項 21】 前記溶媒は超純水であることを特徴とする請求項 13～20 のいずれか 1 項に記載の薬液供給装置。

【請求項 22】 前記細管部材は、導電性のものであることを特徴とする請求項 13～21 のいずれか 1 項に記載の薬液供給装置。

【請求項 23】 前記細管部材は、アモルファスカーボンからなることを特

徴とする請求項 22 に記載の薬液供給装置。

【請求項 24】 移動容易な少なくとも一種の薬液貯蔵槽と、
前記薬液貯蔵槽に対応して連結する請求項 13～23 のいずれか 1 項に記載の
薬液供給装置と、

前記供給流路とを備え、

前記薬液供給装置の前記薬液供給ポンプの駆動により、前記供給流路の端部に
設けられた溶液供給口から所望濃度とされた前記混合溶液を吐出することを特徴
とする薬液供給システム。

【請求項 25】 各々所定薬液が貯蔵された複数の前記薬液貯蔵槽に対応し
て、複数の前記薬液供給装置が前記各薬液貯蔵槽に連結されており、

前記各薬液供給装置を任意に駆動して、所望順序で前記各薬液を前記供給流路
内を通過する前記溶媒に混合することを特徴とする請求項 24 に記載の薬液供給
システム。

【請求項 26】 設置された基板に洗浄液を供給して洗浄する基板洗浄装置
であって、

請求項 24 又は 25 に記載の薬液供給システムを備え、前記混合溶液を前記洗
浄液として用いることを特徴とする基板洗浄装置。

【請求項 27】 基板毎に装着し、当該基板を円周方向に回転させながら前
記洗浄液を供給する基板枚葉スピン洗浄装置であることを特徴とする請求項 26
に記載の基板洗浄装置。

【請求項 28】 請求項 1～12 のいずれか 1 項に記載の薬液供給ポンプを
用いた薬液供給方法であって、

前記薬液供給ポンプを駆動して、前記薬液を前記供給流路を通過する溶媒内に
吐出し、所望濃度の混合溶液を調合することを特徴とする薬液供給方法。

【請求項 29】 前記薬液の吐出方向を前記溶媒の流動方向とほぼ直交する
方向とし、

前記薬液供給ポンプにより、前記細管部材から吐出する前記薬液の線速度が前
記供給流路を通過する前記溶媒の線速度より大きくなるような押圧を前記薬液に
与えることを特徴とする請求項 28 に記載の薬液供給方法。

【請求項 30】 所望濃度とされた混合溶液を前記供給流路の端部に設けられた溶液供給口から吐出することを特徴とする請求項 28 又は 29 に記載の薬液供給方法。

【請求項 31】 複数の前記薬液供給ポンプを用い、前記各薬液供給ポンプを任意に駆動して、所望順序で前記各薬液を前記供給流路内を通過する前記溶媒に混合することを特徴とする請求項 28～30 のいずれか 1 項に記載の薬液供給方法。

【請求項 32】 設置された基板に洗浄液を供給して洗浄する基板洗浄方法であって、

請求項 28～31 のいずれか 1 項に記載の薬液供給方法により前記混合溶液を前記洗浄液として用いて前記基板表面を洗浄することを特徴とする基板洗浄方法。

【請求項 33】 基板毎に装着し、当該基板を円周方向に回転させながら前記洗浄液を供給する基板枚葉スピン洗浄装置を用いることを特徴とする請求項 32 に記載の基板洗浄方法。

【請求項 34】 薬液が溶媒に混合希釈されてなる混合溶液を供給する薬液供給システムであって、

高濃度の前記薬液が貯蔵される移動容易な薬液貯蔵槽と、

所定量の前記薬液を前記薬液貯蔵槽から吸引して送出する薬液供給手段と、

前記薬液供給手段と連結された前記溶媒の流路を形成し、端部に前記溶液の吐出部を有する配管系とを備え、

使用時において、必要量の前記薬液を前記配管系内を流動する前記溶媒に混合させ、所望濃度の前記混合溶液を生成し、前記吐出部から当該混合溶液を供給することを特徴とする薬液供給システム。

【請求項 35】 前記薬液供給手段は、所定薬液を通過させる流路が形成され、前記流路の流入口に前記薬液の圧力上昇により閉じる吸引弁が、前記流路の流出口に前記薬液の圧力下降により閉じる吐出弁がそれぞれ設けられてなる薬液供給ポンプであって、

前記流路における接液面の少なくとも一部が前記薬液に対する不透過性且つ高

耐蝕性の緻密部材からなるとともに、前記緻密部材の一部が可動壁とされており

、

前記可動壁と連結する加振器を備え、前記加振器の駆動により前記可動壁をその壁面とはほぼ直交する方向に振動させて前記流路の体積を周期的に変化させるものであることを特徴とする請求項 34 に記載の薬液供給システム。

【請求項 36】 前記配管系と前記薬液供給手段とを連結する連結流路を備え、

前記連結流路内に前記配管系と直接連結し、前記薬液の前記溶媒への吐出部位となる細管部材が設けられていることを特徴とする請求項 34 又は 35 に記載の薬液供給システム。

【請求項 37】 設置された基板に洗浄液を供給して洗浄する基板洗浄装置であって、

請求項 34～36 のいずれか 1 項に記載の薬液供給システムを備え、前記混合溶液を前記洗浄液として用いることを特徴とする基板洗浄装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、薬液を所望量だけ正確に供給する薬液供給ポンプ、薬液供給装置及び薬液供給システム（薬液供給方法）に関し、特に半導体ウェハ等を洗浄する基板洗浄装置（基板洗浄方法）に適用して好適である。

【0002】

【従来の技術】

従来、半導体ウエットプロセスにおいては、超純水や薬液からなる洗浄液により洗浄等の処理を行う基板洗浄装置が用いられる。このような基板洗浄装置としては、基板毎に装着し、当該基板を円周方向に回転させながら洗浄液を供給する基板枚葉スピン洗浄装置が注目されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

従来の基板洗浄装置では、洗浄に必要な各種薬液を所望の濃度で用意しておく

ための複数の大型の洗浄液貯蔵タンクを設けることが必須とされていた。従ってこの場合、装置全体としては必然的に極めて大規模且つ複雑なものとなる。

【0004】

また、上記のように必要な洗浄液の種類に応じて複数の洗浄液貯蔵タンクを用意する必要性から、洗浄液の調合時にパーティクルが混入し易く、更には基板洗浄装置の複雑化に起因する各種接液部からのパーティクルや（メタル）コンタミネーションの発生が問題視されている。

【0005】

このように現在のところ、基板洗浄装置の高速洗浄化に伴う装置全体の大規模化や複雑化を避けることは困難であり、洗浄液へのパーティクル混入等を防止する技術の確立が強く望まれている現況にある。

【0006】

そこで本発明の目的は、薬液貯蔵槽（薬液貯蔵タンク）を含む洗浄液供給系の大幅な小型化・簡易化を図るとともに、洗浄に必要なときに正確な薬液濃度の洗浄液を簡易且つ迅速に調合し供給することを可能とし、パーティクル等の発生及び洗浄液への混入を極限まで抑止することを実現する薬液供給ポンプ、薬液供給装置、薬液供給システム、基板洗浄装置、薬液供給方法、及び基板洗浄方法を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明の薬液供給ポンプは、所定薬液を通過させる流路が形成され、前記流路の流入口に前記薬液の圧力上昇により閉じる吸引弁が、前記流路の流出口に前記薬液の圧力下降により閉じる吐出弁がそれぞれ設けられてなる薬液供給ポンプであって、前記流路における接液面の少なくとも一部が前記薬液に対する不透過性且つ高耐蝕性の緻密部材からなるとともに、前記緻密部材の一部が可動壁とされており、前記可動壁と連結する加振器を備え、前記加振器の駆動により前記可動壁をその壁面とほぼ直交する方向に振動させて前記流路の体積を周期的に変化させる。

【0008】

本発明の薬液供給ポンプの一態様において、前記緻密部材は、導電性のものである。

【0009】

本発明の薬液供給ポンプの一態様において、導電性の前記緻密部材は、アモルファスカーボンからなる。

【0010】

本発明の薬液供給ポンプの一態様は、前記可動壁と前記加振器との間に、前記加振器からの振動を前記可動壁へ伝達する駆動伝達手段を備える。

【0011】

本発明の薬液供給ポンプの一態様は、前記駆動伝達手段を弾発付勢する弾性手段を備える。

【0012】

本発明の薬液供給ポンプの一態様において、前記加振器は圧電変換により前記可動壁を振動させる圧電振動子である。

【0013】

本発明の薬液供給ポンプの一態様は、前記可動壁と対向する前記接液面の少なくとも一部を構成する対向壁を導電性の前記緻密部材とし、前記流路を通過する前記薬液を誘電体として挟持する前記可動壁と前記対向壁により形成されるキャパシタの静電容量を計測する。

【0014】

本発明の薬液供給ポンプの一態様において、前記可動壁は、中心から周縁へ向かうにつれて厚くなる形状とされている。

【0015】

本発明の薬液供給ポンプの一態様は、前記可動壁と前記駆動伝達手段との間に、前記駆動伝達手段からの圧力を前記可動壁に均一に伝達する補助部材が設けられている。

【0016】

本発明の薬液供給ポンプの一態様において、前記駆動伝達手段は、前記可動壁に対する直接的な振動伝達部位を押圧した際に前記薬液から受ける反作用を見込

んで、前記振動伝達部位及び前記反作用の大きい部位が厚く形成されている。

【0017】

本発明の薬液供給ポンプの一態様は、前記流路の接液部で前記薬液が溜まり易い隅部位及び前記薬液に対する低耐蝕性部位を通るようにガス通気系が設けられており、前記ガス通気系に所定ガスを通気させる。

【0018】

本発明の薬液供給ポンプの一態様において、前記隅部位及び前記低耐蝕性部位は、少なくとも前記吸引弁、前記吐出弁及び前記可動壁の各々の周縁を含む。

【0019】

本発明の薬液供給装置は、前記薬液供給ポンプと、前記薬液が混合する溶媒の通路である供給流路と前記薬液供給ポンプとを連結する連結流路とを備え、前記連結流路内に前記供給流路と直接連結する細管部材が設けられており、前記薬液供給ポンプの駆動により、前記細管部材から前記供給流路を通過する前記溶媒内に前記薬液を吐出し、所望濃度の混合溶液を調合する。

【0020】

本発明の薬液供給装置の一態様において、前記薬液の吐出方向は前記溶媒の流動方向とはほぼ直交する方向であり、前記薬液供給ポンプは、前記細管部材から吐出する前記薬液の線速度が前記供給流路を通過する前記溶媒の線速度より大きくなるような押圧を前記薬液に与える。

【0021】

本発明の薬液供給装置の一態様において、前記連結流路の一部を囲む電極が設けられ、前記電極により前記連結流路を通過する前記薬液の静電容量を計測する。

【0022】

本発明の薬液供給装置の一態様は、前記細管部材の近傍における前記連結流路の一部を囲む薬液吐出停止手段を備え、前記薬液供給ポンプの停止に同期して、前記細管部材から前記供給流路内の前記溶媒を若干量吸引する。

【0023】

本発明の薬液供給装置の一態様において、前記薬液吐出停止手段は、前記薬液

を所定温度に加熱する電熱機構を有しており、前記薬液供給ポンプの停止に同期して前記電熱機構による加熱を停止する。

【0024】

本発明の薬液供給装置の一態様において、前記薬液吐出停止手段は、圧搾機構を有しており、前記薬液供給ポンプの停止に同期して駆動する。

【0025】

本発明の薬液供給装置の一態様において、前記細管部材は、前記薬液を所定温度に加熱する電熱機構を有しており、前記薬液供給ポンプの停止に同期して前記電熱機構による加熱を停止して、前記供給流路内の前記溶媒を若干量吸引する。

【0026】

本発明の薬液供給装置の一態様において、前記細管部材の前記供給流路との連結部位近傍に一对の温度検出素子を埋め込み、前記薬液供給ポンプに同期して前記各温度検出素子の温度差を検出し、前記混合溶液の流動状態をモニターする。

【0027】

本発明の薬液供給装置の一態様において、前記溶媒は超純水である。

【0028】

本発明の薬液供給装置の一態様において、前記細管部材は、導電性のものである。

【0029】

本発明の薬液供給装置の一態様において、前記細管部材は、アモルファスカーボンからなる。

【0030】

本発明の薬液供給システムは、移動容易な少なくとも一種の薬液貯蔵槽と、前記薬液貯蔵槽に対応して連結する前記薬液供給装置と、前記供給流路とを備え、前記薬液供給装置の前記薬液供給ポンプの駆動により、前記供給流路の端部に設けられた溶液供給口から所望濃度とされた前記混合溶液を吐出する。

【0031】

本発明の薬液供給システムの一態様において、各々所定薬液が貯蔵された複数の前記薬液貯蔵槽に対応して、複数の前記薬液供給装置が前記各薬液貯蔵槽に連

結されており、前記各薬液供給装置を任意に駆動して、所望順序で前記各薬液を前記供給流路内を通過する前記溶媒に混合する。

【0032】

本発明の基板洗浄装置は、設置された基板に洗浄液を供給して洗浄するものであって、前記薬液供給システムを備え、前記混合溶液を前記洗浄液として用いる。

【0033】

本発明の基板洗浄装置の一態様は、基板毎に装着し、当該基板を円周方向に回転させながら前記洗浄液を供給する基板枚葉スピン洗浄装置である。

【0034】

本発明の薬液供給方法は、前記薬液供給ポンプを用いた薬液供給方法であって、前記薬液供給ポンプを駆動して、前記薬液を前記供給流路を通過する溶媒内に吐出し、所望濃度の混合溶液を調合する。

【0035】

本発明の薬液供給方法の一態様において、前記薬液の吐出方向を前記溶媒の流動方向とはほぼ直交する方向とし、前記薬液供給ポンプにより、前記細管部材から吐出する前記薬液の線速度が前記供給流路を通過する前記溶媒の線速度より大きくなるような押圧を前記薬液に与える。

【0036】

本発明の薬液供給方法の一態様は、所望濃度とされた混合溶液を前記供給流路の端部に設けられた溶液供給口から吐出する。

【0037】

本発明の薬液供給方法の一態様は、複数の前記薬液供給ポンプを用い、前記各薬液供給ポンプを任意に駆動して、所望順序で前記各薬液を前記供給流路内を通過する前記溶媒に混合する。

【0038】

本発明の基板洗浄方法は、設置された基板に洗浄液を供給して洗浄するものであって、前記薬液供給方法により前記混合溶液を前記洗浄液として用いて前記基板表面を洗浄する。

【0039】

本発明の基板洗浄方法の一態様は、基板毎に装着し、当該基板を円周方向に回転させながら前記洗浄液を供給する基板枚葉スピン洗浄装置を用いる。

【0040】

本発明の薬液供給システムは、薬液が溶媒に混合希釈されてなる混合溶液を供給するものであって、高濃度の前記薬液が貯蔵される移動容易な薬液貯蔵槽と、所定量の前記薬液を前記薬液貯蔵槽から吸引して送出する薬液供給手段と、前記薬液供給手段と連結された前記溶媒の流路を形成し、端部に前記溶液の吐出部を有する配管系とを備え、使用時において、必要量の前記薬液を前記配管系内を流動する前記溶媒に混合させ、所望濃度の前記混合溶液を生成し、前記吐出部から当該混合溶液を供給する。

【0041】

本発明の薬液供給システムの一態様において、前記薬液供給手段は、所定薬液を通過させる流路が形成され、前記流路の流入口に前記薬液の圧力上昇により閉じる吸引弁が、前記流路の流出口に前記薬液の圧力下降により閉じる吐出弁がそれぞれ設けられてなる薬液供給ポンプであって、前記流路における接液面の少なくとも一部が前記薬液に対する不透過性且つ高耐蝕性の緻密部材からなるとともに、前記緻密部材の一部が可動壁とされており、前記可動壁と連結する加振器を備え、前記加振器の駆動により前記可動壁をその壁面とほぼ直交する方向に振動させて前記流路の体積を周期的に変化させるものである。

【0042】

本発明の薬液供給システムの一態様は、前記配管系と前記薬液供給手段とを連結する連結流路を備え、前記連結流路内に前記配管系と直接連結し、前記薬液の前記溶媒への吐出部位となる細管部材が設けられている。

【0043】

本発明の基板洗浄装置は、設置された基板に洗浄液を供給して洗浄するものであって、前記薬液供給システムを備え、前記混合溶液を前記洗浄液として用いる。

【0044】

【作用】

本発明の薬液供給ポンプは、加振器により可動壁を駆動制御して振動させ、その押圧により薬液を吐出するものであり、所望量の薬液を正確に吐出供給することができる。ここで、接液面の少なくとも一部が薬液に対する不透過性且つ高耐蝕性の緻密部材、好ましくはアモルファスカーボンを用いる。このアモルファスカーボンは、その気孔率の制御が容易な材料であり、気孔率をほぼ0のものは極めて優れた不透過性且つ高耐蝕性を示す。従って、このアモルファスカーボンを接液面の重要部分に設けることにより、薬液の供給量制御がより正確となり、しかもパーティクル等の薬液内への混入が抑止される。

【0045】

更に本発明では、この薬液供給ポンプを構成要素とする薬液供給装置を提供する。この薬液供給装置は、薬液供給ポンプの駆動により供給流路を通過する超純水を代表とする溶媒に細管部材から薬液を混合するものであり、種々の濃度の混合溶液を必要に応じて容易に調合することができる。ここで、薬液の吐出方向が前記溶媒の流動方向とほぼ直交する方向である場合には、細管部材から吐出する薬液の線速度が供給流路を通過する溶媒の線速度より十分に大きくなるような押圧を薬液に与えることにより、薬液が溶媒内で供給流路の対向壁面まで到達し、均一な濃度の混合溶液が瞬間的に調合されることになる。

【0046】

更に本発明では、この薬液供給装置を構成要素とし、前記混合溶液を供給するための薬液供給システムを提供する。この薬液供給システムでは、上述のように必要に応じた所望濃度の混合溶液の生成が可能であるため、原液である薬液の貯蔵槽は移動容易な小型のもので足りる。即ち、この薬液供給システムにおいては、従来のように薬液濃度や種類の異なる極めて大型の混合溶液の貯蔵槽を用意する必要がなく、混合溶液へのパーティクル混入等を抑止できるのみならず、システム全体の規模の大幅な縮小化・簡易化が実現される。従って、この薬液供給システムを例えば基板洗浄装置に適用することにより、濃度や種類の異なる種々の清浄な洗浄液（混合溶液）を迅速且つ容易に供給することが可能となる。

【0047】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の基板洗浄装置の具体的な実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。本実施形態の基板洗浄装置は、ウェハ毎に装着し、当該ウェハを円周方向に回転させながら洗浄液を供給するものであり、半導体ウェハ等のウェット洗浄プロセスにおいて広範囲の機能を実現できるウェハ枚葉スピン洗浄装置である。

【0048】

図1は、本実施形態の基板洗浄装置の全体構成を示す概略断面図である。

この基板洗浄装置は、基板（ウェハ）11が設置されて洗浄が行なわれる洗浄チャンバー1と、所望の薬液濃度の洗浄液を生成して供給する薬液供給システム2とを備えて構成されている。

【0049】

洗浄チャンバー1は、図2に示すように、洗浄するウェハ11が収められる閉空間を形成しており、ウェハ11の搬出入部位となるゲートバルブ12を備えている。この洗浄チャンバー1は、ウェハ11を側面から保持するウェハ保持ピン13を有し、固定されたウェハ11を図2中矢印の方向に回転させる回転駆動モータを備えたウェハ設置手段14と、ウェハ設置手段14を側方から包囲するように設けられた洗浄液衝突緩衝板15とを備えて構成されている。ここで、洗浄液衝突緩衝板15は必ずしも必要とは限らず、洗浄チャンバーの形状に多少の曲面を持たせることにより、洗浄液衝突緩衝板15の役割を代替せしめることも可能である。

【0050】

なお、洗浄チャンバー1内には、N₂ ガス又は不活性ガス等を供給するためのノズル（不図示）が設けられており、洗浄後にウェハ11を乾燥させる際にウェハ11の表面、または表裏面同時にN₂ ガス等を吹き付けながら高速回転することによってウェハ11を乾燥させたり、洗浄チャンバー1内を高濃度のN₂ ガス又は不活性ガス等で置換した状態でウェハ11の洗浄を行なうことなどができる。

【0051】

薬液供給システム 2 は、洗浄用の薬液が原液の状態で作蔵される薬液貯蔵タンク 2 1 と、薬液貯蔵タンク 2 1 と連結され、薬液供給を能動的に行なう薬液供給装置 2 2 と、薬液供給装置 2 2 と連結され、薬液が混合する超純水の通路となる供給流路を形成する配管系 2 3 と、洗浄チャンバー 1 内で設置されるウェハ 1 1 の各表面と対向するように配管系 2 3 の端部に設けられ、前記各表面に洗浄液を供給する一対の吐出ノズル 2 4, 2 5 とを備えて構成されている。

【0052】

薬液貯蔵タンク 2 1 は、高濃度の原液状態の薬液、ここでは H F が貯蔵されており、搬入・搬出等の移動容易な小型サイズのものである。この薬液貯蔵タンク 2 1 は、薬液の種類等に応じて複数設けられる場合もある。

【0053】

薬液供給装置 2 2 は、圧電効果を利用して薬液貯蔵タンク 2 1 から薬液を振動的に送り出す動作を行なうダイヤフラムポンプである薬液供給ポンプ 3 1 と、配管系 2 3 と薬液供給ポンプ 3 1 とを連結して連結流路を形成する連結管 3 2 と、連結管 3 2 内に配管系 2 3 の供給流路と直接連結する細管部材（キャピラリー） 3 3 とを備えて構成されている。

【0054】

薬液供給ポンプ 3 1 は、図 3 ～図 6 及び図 7 に示すように、薬液を通過させる流路 4 1 が形成され、この流路 4 1 の流入口に薬液の圧力上昇により閉じる吸引弁 4 2 が、流路 4 1 の流出口に薬液の圧力下降により閉じる吐出弁 4 3 がそれぞれ設けられてなるものである。ここで、流路 4 1 における接液面の一部を構成する一対の対向する側壁 4 4, 4 5 が薬液に対する不透過性且つ高耐蝕性の緻密部材、ここでは導電性部材であるアモルファスカーボンを主材料としてなり、側壁 4 4 が可動壁とされている。

【0055】

そして、この薬液供給ポンプ 3 1 は、この側壁（可動壁） 4 4 と連結し、当該可動壁 4 4 をその壁面とほぼ直交する方向に振動させて流路 4 1 の体積を周期的に変化させる加振器である圧電振動子 4 6 と、可動壁 4 4 と圧電振動子 4 6 との間に設けられ、圧電振動子 4 6 からの振動を可動壁 4 4 へ伝達する駆動伝達手段

4 7 と、圧電振動子 4 6 が縮み方向には圧力を発生できないことを考慮した手段であり、駆動伝達手段 4 7 を弾発付勢するスプリング 4 8 とを備えて構成されている。

【 0 0 5 6 】

側壁 4 4 , 4 5 の主材料であるアモルファスカーボンは、上記の如く不透過性且つ高耐蝕性を有しており、ウェハ 1 1 の洗浄に用いられる薬液、特にフッ化水素酸や過酸化水素水、オゾン等の酸化剤に対して全く汚染を受けない性質を持つ。ここで用いるアモルファスカーボンとしては、均質アモルファスカーボンや繊維状アモルファスカーボン、または両者の複合材料が好ましい。均質アモルファスカーボンは、気孔のない緻密な等方性組織を有し、ガスバリヤー性及び液体遮断性に優れた材料であり、用途に応じて気孔率の制御も可能である。繊維状アモルファスカーボンは、3次元の骨格組織を有する炭素多孔体であり、気孔の均一性を持ったポーラスカーボンである。

【 0 0 5 7 】

ここで、アモルファスカーボンの不透過性・高耐蝕性を調べた実験例について説明する。この実験は、気孔率が 0 % であるアモルファスカーボン配管（外径約 6 mm、内径約 4 mm）を用いて、フッ酸原液から希フッ酸調整系への供給ラインを構築し、使用を重ねた場合の各種金属の溶出度を調べたものである。実験結果を以下の表 1 に示す。

【 0 0 5 8 】

【表 1】

溶出成分濃度：ppd								
溶出成分	Al	Ca	Mg	Na	Fe	Ni	Cr	Ti
1週間後成分濃度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
1ヶ月後成分濃度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

試料面積：40×10×2 [mm]

HF50%使用量：1[kg]

【 0 0 5 9 】

このように、1 ヶ月にわたる長期使用を重ねても、濃厚フッ酸原液（HF 5 0

%)に全く溶出成分を与えないことが分かる。従って、このアモルファスカーボンを用いることにより高純度希フッ酸の調整が可能となる。

【0060】

フッ素樹脂で構築される従来の薬液供給システムは、フッ素樹脂中のHF分子の拡散が避けられないため、長期的には微量HF拡散を抑止できないという欠陥があった。本実施形態のように、アモルファスカーボンを接液部に適用することにより、この問題を解決することができる。

【0061】

可動壁44は、ダイヤフラムとして機能するものであり、図8(b)に示すように、中心から周縁へ向かうにつれて厚くなる形状とされている。この形状は、可動壁44の受ける圧力が最大となる部位が中心近傍であり、ここが特に繰り返し変形する部分となることに加え、固定部となる周縁近傍の補強を考慮して、一部位にかかる機械的応力を分散するための最適形状である。図8(a)に示すように、例えば可動壁44を均一な厚みとした場合、機械的応力が中心近傍に集中して耐久性を損なうおそれがある。なお、図9に示すように、可動壁44を中心から周縁へ向かうにつれて厚くなるとともに、断面が図中で左右対称形状となるように形成しても好適である。

【0062】

更に、図10に示すように、可動壁44と駆動伝達手段47との間に、当該駆動伝達手段47からの圧力を可動壁44に均一に伝達して機械的応力を分散するための補助部材51が設けられている。この補助部材51の具体例としては、図10(a)のように、ゴム又は弾性接着剤からなり、圧力に応じた形状の同心円状のOリング群51aや、図10(b)のように、Oリング群51aと同様の効果を奏するシート51b等が好ましい。

【0063】

駆動伝達手段47は、SUS製のものであり、図11(a)に示すように、可動壁44に対する直接的な振動伝達部位(中心近傍)を押圧した際に薬液から受ける反作用を見込んで、中心近傍及び前記反作用の大きい部位が厚く形成されている。即ち、図11(b)に示すように、可動壁44の中心近傍に最大圧力が作

用すると流路41内の薬液からの反作用は可動壁44の周縁近傍で最大となる。そこでこの反作用を見込んで、駆動伝達手段47を図示の如く中心近傍47aに続いて周縁近傍47bの厚みが大きい形状とすれば、可動壁44に作用する圧力は全体的にはほぼ均一となる。なおこの場合、補助部材51に図11(a)中で上下方向の力による変形を可及的に抑止するため、補助部材51に切り込み等を施すことが好ましい。

【0064】

この薬液供給ポンプ31の動作は以下の通りである。ダイヤフラムである可動壁44が図7中右側へ移動したときには、流路41は負圧となって吐出弁43が閉止状態となり、図12のように左側へ移動したときには、流路41は正圧となって吸引弁42が閉止状態となると共に吐出弁43が開放状態となって薬液が吐出される。ここで、圧電振動子46の駆動による可動壁44の振動数は例えば20Hz程度に制御することが好ましく、薬液の吐出圧力は例えば1.5kg/cm²以上とすることが好適である。

【0065】

細管部材であるキャピラリー33は、側壁44、45と同様のアモルファスカーボンを主材料としてなり、管径が例えば ϕ 0.2mm程度、吐出量が例えば0.3cc/秒とされている。薬液供給ポンプ31の振動駆動により、このキャピラリー33から配管系23内の超純水中へ薬液が吐出される。

【0066】

配管系23は、上記の如き超純水の供給流路を形成しており、管径が例えば ϕ 5mm程度、流量が例えば3.4リットル/分程度とされている。この配管系23内への薬液の吐出条件は以下のようになる。

【0067】

一般的に、管内を通過する流体のどの断面をとっても単位時間当たりの通過量が一定であるような流れを定常流と称する。定常流には層流と乱流の2つの形態がある。層流は、流線が流路軸に対して直線形状を保つ流れであり、流量は比較的小さい。他方、乱流は、流線が不規則に渦巻く状態となる流れであり、流量は比較的大きい。層流と乱流の現れる条件は所謂レイノルズ数で分類されることが

知られている。レイノルズ数が2000以下のときには攪乱を加えて流線を乱してみても下流は層流に戻ってしまう。レイノルズ数が2300～3000である範囲が層流と乱流の境界（臨界レイノルズ数）と見做されている。

【0068】

ここで、レイノルズ数を R （無次元）、管の内径を D （cm）、液の線速度を u （cm/秒）、液の動粘度を ν （cm²/秒）、液の粘度を η （dyn・秒）、液の密度を ρ （g/cm³）とすると、レイノルズ数 R は、

$$\begin{aligned} R &= D \cdot u / \nu \\ &= D \cdot u \cdot \rho / \eta \end{aligned}$$

となる。

【0069】

図13は、本実施形態における薬液と超純水との混合点Pにおける薬液拡散パターンを示す模式図である。

まず、比較例としてキャピラリー33を用いずに配管系23に連結管32を直接接続したときの薬液拡散パターンを図13（a）に示す。この場合、薬液の線速度に比して超純水の線速度が大きいため、超純水の層流は乱されることなく、薬液は管壁に沿って非拡散状態のまま輸送されてしまう。

【0070】

それに対して本実施形態の場合は、図13（b）に示すように、キャピラリー33の選定により、キャピラリー33から吐出する薬液の線速度が超純水の線速度より十分に大きくなるような押圧（例えば、超純水の流速の約10倍の流速で注入される圧力）を薬液供給ポンプ31によって薬液に与えることにより、薬液が超純水内で配管系23の対向壁面まで到達する。このときの薬液拡散パターンは、側面からみれば、超純水の層流によって流出方向に引き伸ばされた形状となり、正面からみれば、薬液流の先端が対向壁面への衝突により曲げられた形状となり、上面からみれば、薬液流の先端が対向壁面への衝突により両側に分かれて更に流出方向に引き伸ばされた形状となる。即ちこの場合、薬液と超純水との混合溶液（洗浄液）が均一な濃度に調合され、配管系23を通過して輸送されることになる。

【0071】

なお、薬液供給装置22は、図14に示すように、その薬液の種類等に応じて複数設置される場合もある（図示の例ではA、B、Cの3つ）。この場合、各薬液供給装置22が任意に駆動して、所望順序で各薬液を配管系23の供給流路内を通過する超純水に混合し、各々所望の洗浄液が順次吐出ノズル24、25からウェハ11表面に供給されることになる。

【0072】

このように、本実施形態の基板洗浄装置においては、先ず薬液供給ポンプ31により、圧電振動子46が可動壁44を駆動制御して振動させ、その押圧により薬液を吐出するものであり、所望量の薬液を正確に吐出供給することができる。ここで、接液面の少なくとも一部が薬液に対する不透過性且つ高耐蝕性の緻密部材、好ましくはアモルファスカーボンを用いる。このアモルファスカーボンは、その気孔率の制御が容易な材料であり、気孔率をほぼ0のものは極めて優れた不透過性且つ高耐蝕性を示す。従って、このアモルファスカーボンを接液面の重要部分に設けることにより、薬液の供給量制御がより正確となり、しかもパーティクル等の薬液内への混入が抑止される。

【0073】

更に本実施形態では、この薬液供給ポンプ31を構成要素とする薬液供給装置22を提供する。この薬液供給装置22は、薬液供給ポンプ31の駆動により配管系23を通過する超純水にキャピラリー33から薬液を混合するものであり、種々の濃度の混合溶液（洗浄液）を必要に応じて容易に調合することができる。ここで、薬液の吐出方向が超純水の流動方向とほぼ直交する方向である場合には、細管部材から吐出する薬液の線速度が配管系23を通過する超純水の線速度より十分に大きくなるような押圧を薬液に与えることにより、薬液が超純水内で配管系23の対向壁面まで到達し、均一な濃度の混合溶液が瞬間的に調合されることになる。

【0074】

更に本実施形態では、薬液供給装置22を構成要素とし、洗浄液を供給するための薬液供給システム2を提供する。この薬液供給システム2では、上述のよう

に必要な応じた所望濃度の洗浄液の生成が可能であるため、原液である薬液の貯蔵槽 21 は移動容易な小型のもので足りる。即ち、この薬液供給システム 2 においては、従来のように薬液濃度や種類の異なる極めて大型の混合溶液の貯蔵槽を用意する必要がなく、洗浄液へのパーティクル混入等を抑止できるのみならず、システム全体の規模の大幅な縮小化・簡易化が実現される。従って、この薬液供給システム 2 を備えた本例の基板洗浄装置では、濃度や種類の異なる種々の清浄な洗浄液を迅速且つ容易に供給することが可能となる。

【0075】

本実施形態の基板洗浄装置では、上述のように構成された薬液供給システムに、更なるパーティクル発生等の抑止や洗浄液の薬液濃度の正確性を期すため、以下に示すような種々の付加機構を設ける。

【0076】

先ず、配管系 23 内の超純水への薬液注入を停止する際における残存薬液の混入防止機構について説明する。

【0077】

図 15 は、混入防止機構の具体的な一例を示す模式図である。ここでは、電熱機構を持った所謂サックバックデバイスを例示する。このサックバックデバイス 61 は、アモルファスカーボンを主材料としてなり、連結管 32 の一部を被覆するように設けられている。このサックバックデバイス 61 には薬液供給ポンプ 31 の駆動・停止と同期する電源 62 が接続されており、薬液の供給時には電源 62 がオンの状態でサックバックデバイス 61 の電熱機構によりサックバックデバイス 61 近傍の薬液が所定温度に加熱されている。薬液供給ポンプ 31 が停止すると、それに同期して電源 62 がオフとなるが、超純水の流動により発生する圧力がキャピラリー 33 を介して薬液供給ポンプ 31 の吐出弁 43 を閉じるので、薬液が自然冷却により若干収縮し、それに伴ってキャピラリー 33 から薬液供給ポンプ 31 側に配管系 23 内の超純水が若干量吸引される。これにより、キャピラリー 33 内の少なくとも配管系 23 内の超純水と直接的に接する部位内が超純水と置換され、薬液が配管系 23 内の超純水と完全に遮断されることになる。

【0078】

また、サックバックデバイス61の代わりに圧搾機構を有するサックバックデバイスを設けてもよい。この場合、例えばプラスチック製のサックバックデバイスにソレノイドを巻回形成し、薬液供給ポンプ31の停止に同期してソレノイドへの電流をオフするように構成する。通常ソレノイドは電流のオフにより径方向に若干膨張し、これによりキャピラリー33から超純水が若干量吸引されることになる。

【0079】

また、図16に示すように、キャピラリー33が導電性を有することを利用して、キャピラリー33に薬液供給ポンプ31の駆動・停止と同期する電気ヒータ63を設けてもよい。この場合、上記のサックバックデバイス61の機能と同様に、薬液供給ポンプ31が停止に同期して電気ヒータ63がオフになると薬液が自然冷却により若干収縮し、それに伴ってキャピラリー33から薬液が若干量吸引されて配管系23内の超純水と完全に遮断される。なお、このキャピラリー33を用いた混入防止機構は、上記のサックバックデバイスと併用しても好適である。

【0080】

次に、薬液供給における薬液内の気泡発生や、薬液供給ポンプ31の駆動により最もダメージを受けやすい可動壁44等の破損を検出する機構について説明する。

【0081】

図17は、気泡・破損検出機構の具体的な一例を示す模式図である。

この気泡・破損検出機構71は、薬液供給ポンプ31の側壁44、45が導電性を有することを利用して、これらに対向電極と見做して流路41内の薬液を誘電体とするキャパシタを構成し、このキャパシタの静電容量を対向電極に接続した静電容量モニター72によりモニターするものである。なおこの場合、側壁44、45の確実なキャパシタ機能を確保するため、側壁（可動壁）44の固定部（この部分もアモルファスカーボンで構成する。）に絶縁材料73を挿入することが好ましい。

【0082】

気泡・破損検出機構 71 による検出動作を図 18 を用いて説明する。

まず、気泡や破損が発生しなければ、図 18 (a) のように静電容量 C はほぼ一定値を示す。そして、例えば流路 41 内の薬液に気泡が発生すると、図 18 (b) のように流路 41 を通過する時間だけ静電容量 C が低下することになる。また、可動壁 44 に破損が生じると、図 18 (c) のように破損時を境に静電容量 C が低下し所定値でほぼ定常状態となる。このように、静電容量 C をモニターすることにより、気泡や破損の発生を容易に検知することができる。

【0083】

また、気泡検出機構の他の例としては、図 19 (a) に示すように、連結管 32 に設置される例えばリング状の一对の電極 75 と、各電極 75 と接続される LCR メーター 76 とを備えて構成される気泡検出機構 74 がある。図 19 (b) を常態として、図 19 (c) に示すように各電極 72 間を通過する薬液内に気泡が発生すると、上記と同様にその時間だけ静電容量 C が低下する。そこで、気泡検出機構 74 を用いて静電容量 C をモニターすることにより、上記と同様に気泡の発生を容易に検知することができる。

【0084】

次に、薬液供給ポンプ 31 から超純水への薬液の吐出量を制御して洗浄液の流動状態、即ち洗浄液が正常に流れているか否かをモニターする機構について説明する。

【0085】

図 20 は、洗浄液流動検知機構の具体的な一例を示す模式図である。

この洗浄液流動検知機構 81 は、キャピラリー 33 と配管系 23 との接合部近傍において、キャピラリー 33 の管壁の両端にそれぞれ埋め込まれた一对のサーミスター温度検出端子 82 を備えており、薬液供給ポンプ 31 の駆動に同期して電気ヒータ 83 がキャピラリー 33 を所定温度に加熱するように構成されている。

【0086】

この洗浄液流動検知機構 81 により各温度検出端子 82 間の温度差を測定し、これにより流量状態の変化を検知する。即ち、超純水は配管系 23 内を図 20 中

矢印で示す方向に流動しており、各温度検出端子 82 間では薬液吐出量に応じた濃度勾配が生じる、この濃度勾配は温度の関数であるため、各温度検出端子 82 間の温度差を測定することにより、薬液吐出量が検知されることになる。このように、洗浄液流動検知機構 81 によれば、洗浄液の流動状態を常に好適な状態に制御することが可能となる。

【0087】

次に、薬液供給ポンプ 31 における薬液又は薬液の蒸気による腐食を防止する機構について説明する。

【0088】

図 5 及び図 6 は、腐食防止機構の具体的な一例を示す模式図（断面図：2 方向）である。

薬液供給ポンプ 31 において、バイパス 49 がフッ素樹脂からなる部分を有し、また可動壁 44、側壁 45 の間には極微小の隙間が形成される場合が考えられる。このような樹脂からなる比較的低耐蝕性の部位や隙間を形成する隅部位には薬液が溜まると、例えば薬液が HF であればそこから薬液の蒸気が発生し易く、腐食を招く一原因となるおそれがある。そこで、腐食防止機構を設けることで薬液又は薬液蒸気からの腐食を防止することができる。この腐食防止機構 91 は、比較的低耐蝕性の部位や隅部位、具体的には吸引弁 42、前記吐出弁 43 及び可動壁 44 の各々の周縁を含む各部位を通るキャリアガスの通気系 92（図 5 及び図 6 中、矢印で示す。）を備えて構成されている。この通気系 92 に N_2 ガス等を通気させることにより、比較的低耐蝕性の部位や隅部位に薬液が溜まることなく、流路 41 の規制された領域のみを薬液が通過することになる。従って、薬液や薬液蒸気による腐食を防止することができる。

【0089】

なお、本発明はこの実施形態に限定されるものではない。例えば、薬液供給システムは基板洗浄装置のみならず、種々の種類や濃度の大量の薬液が必要な他のあらゆる装置に適用可能である。

【0090】

【発明の効果】

本発明によれば、薬液貯蔵槽（薬液貯蔵タンク）を含む洗浄液供給系の大幅な小型化・簡易化を図るとともに、洗浄に必要なときに正確な薬液濃度の洗浄液を簡易且つ迅速に調合し供給することが可能となり、パーティクル等の発生及び洗浄液への混入を極限まで抑止することが実現する。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本実施形態に係る薬液供給システムを含むウェハ枚葉スピン洗浄装置の一例を示す模式図である。

【図 2】

本実施形態に係るウェハ枚葉スピン洗浄装置の構成要素である洗浄チャンバーの一例を示す概略断面図である。

【図 3】

薬液供給システムの構成要素である薬液供給ポンプを示す概略正面図である。

【図 4】

図 3 中一点鎖線 I-I' に沿った概略断面図である。

【図 5】

図 3 中一点鎖線 II-II' に沿った概略断面図である。

【図 6】

図 3 中一点鎖線 III-III' に沿った概略断面図である。

【図 7】

薬液供給システムの構成要素である薬液供給ポンプの流路近傍を示す概略断面図である。

【図 8】

薬液供給ポンプの構成要素である可動壁を示す概略断面図である。

【図 9】

可動壁の好適な他の例を示す概略断面図である。

【図 10】

可動壁の補助部材を示す概略斜視図である。

【図 11】

薬液供給ポンプの構成要素である駆動伝達手段及び可動壁にかかる反作用の様子を示す概略断面図である。

【図 1 2】

薬液供給ポンプが駆動する際の流路近傍を示す概略断面図である。

【図 1 3】

薬液と超純水との混合点における薬液拡散パターンを示す模式図である。

【図 1 4】

薬液供給装置が複数設けられた場合を示す模式図である。

【図 1 5】

パーティクル等の混入防止機構の具体的な一例を示す模式図である。

【図 1 6】

パーティクル等の混入防止機構の具体的な他の例を示す模式図である。

【図 1 7】

気泡・破損検出機構の具体的な一例を示す模式図である。

【図 1 8】

気泡・破損検出機構による静電容量のモニターを示す特性図である。

【図 1 9】

気泡・破損検出機構の具体的な他の例を示す模式図である。

【図 2 0】

洗浄液濃度調整機構の具体的な一例を示す模式図である。

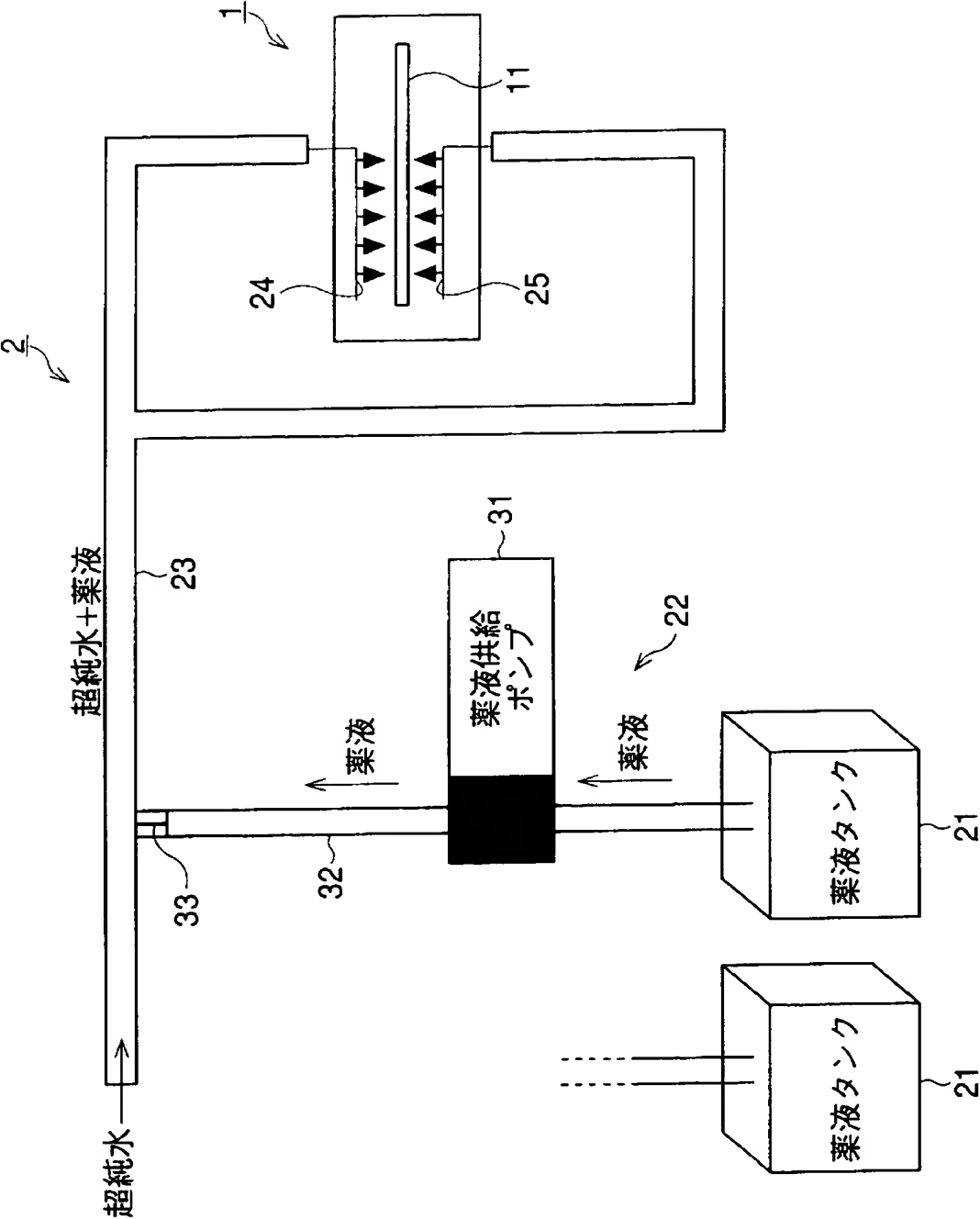
【符号の説明】

- 1 洗浄チャンバー
- 2 薬液供給システム
 - 1 1 ウェハ
 - 1 2 ゲートバルブ
 - 1 3 ウェハ保持ピン
 - 1 4 ウェハ設置手段
 - 1 5 洗浄液衝突緩衝板
- 2 1 薬液貯蔵タンク

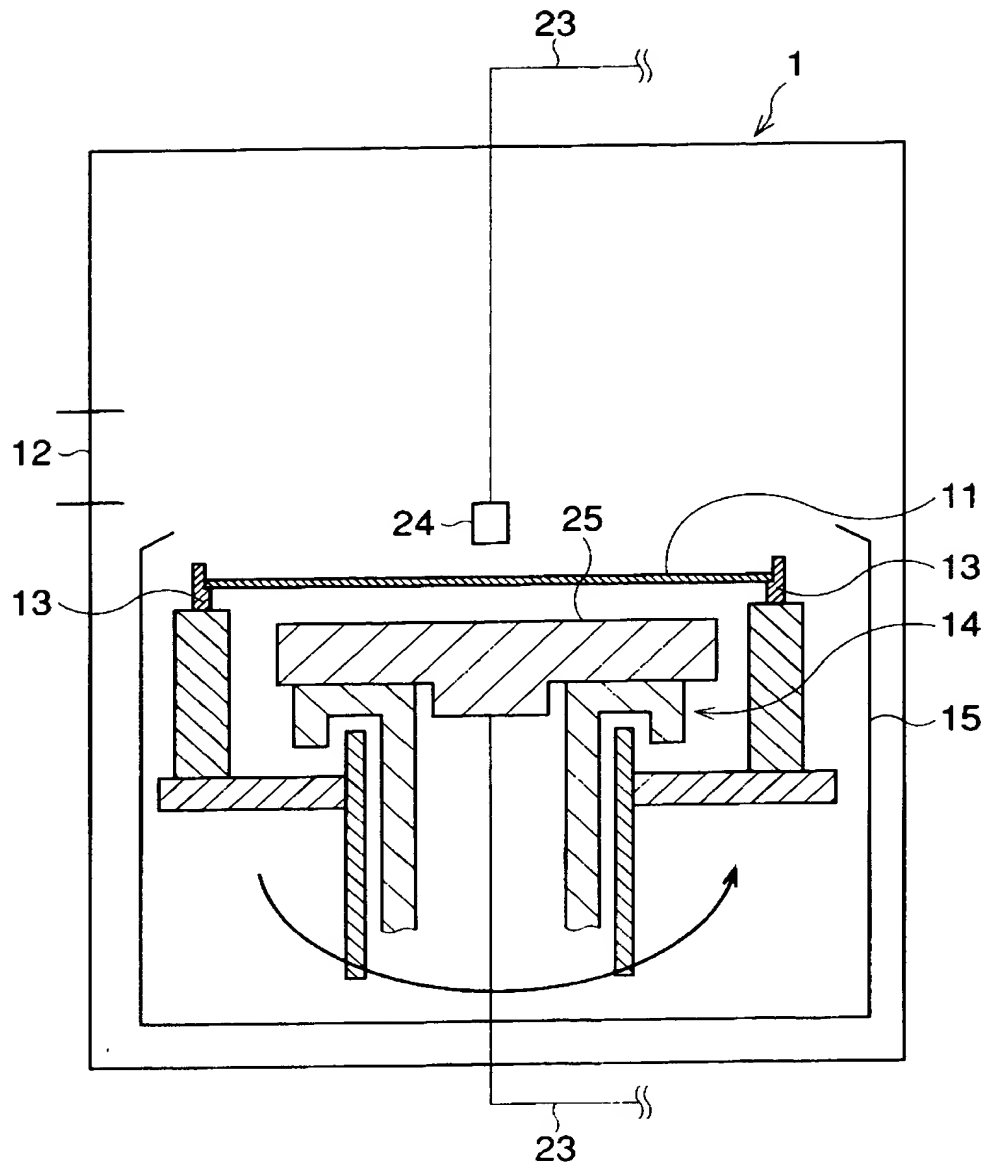
- 2 2 薬液供給装置
- 2 3 配管系
- 2 4, 2 5 吐出ノズル
- 3 1 薬液供給ポンプ
- 3 2 連結管
- 3 3 キャピラリー
- 4 1 流路
- 4 2 吸引弁
- 4 3 吐出弁
- 4 4, 4 5 側壁
- 4 6 圧電振動子
- 4 7 駆動伝達手段
- 4 8 スプリング
- 5 1 補助部材
- 5 1 a Oリング群
- 5 1 b シート
- 6 1 サックバックデバイス
- 6 2 電源
- 6 3 電気ヒータ
- 7 1 気泡・破損検出機構
- 7 2 静電容量モニター
- 7 3 絶縁材料
- 7 4 気泡検出機構
- 8 1 洗浄液流動検知機構
- 8 2 サーミスター温度検出端子
- 8 3 電気ヒータ
- 9 1 混入抑止機構
- 9 2 通気系

【書類名】 図面

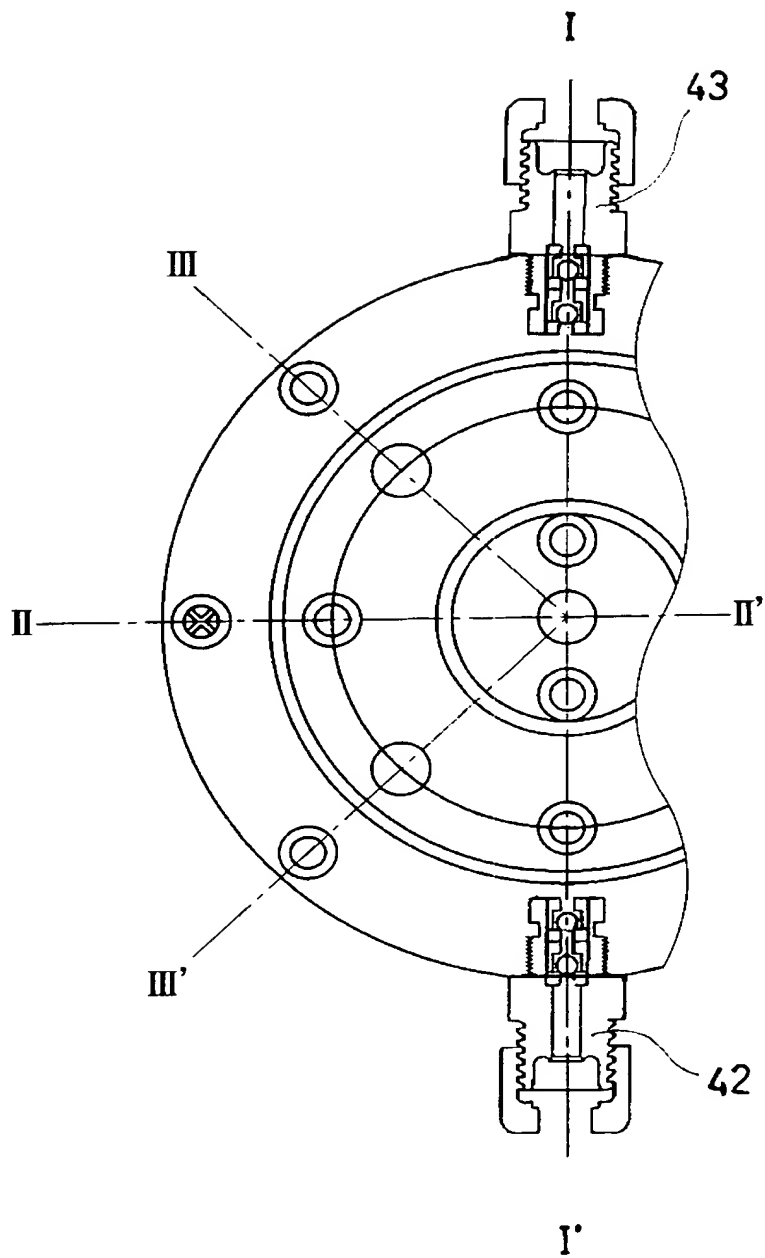
【図 1】



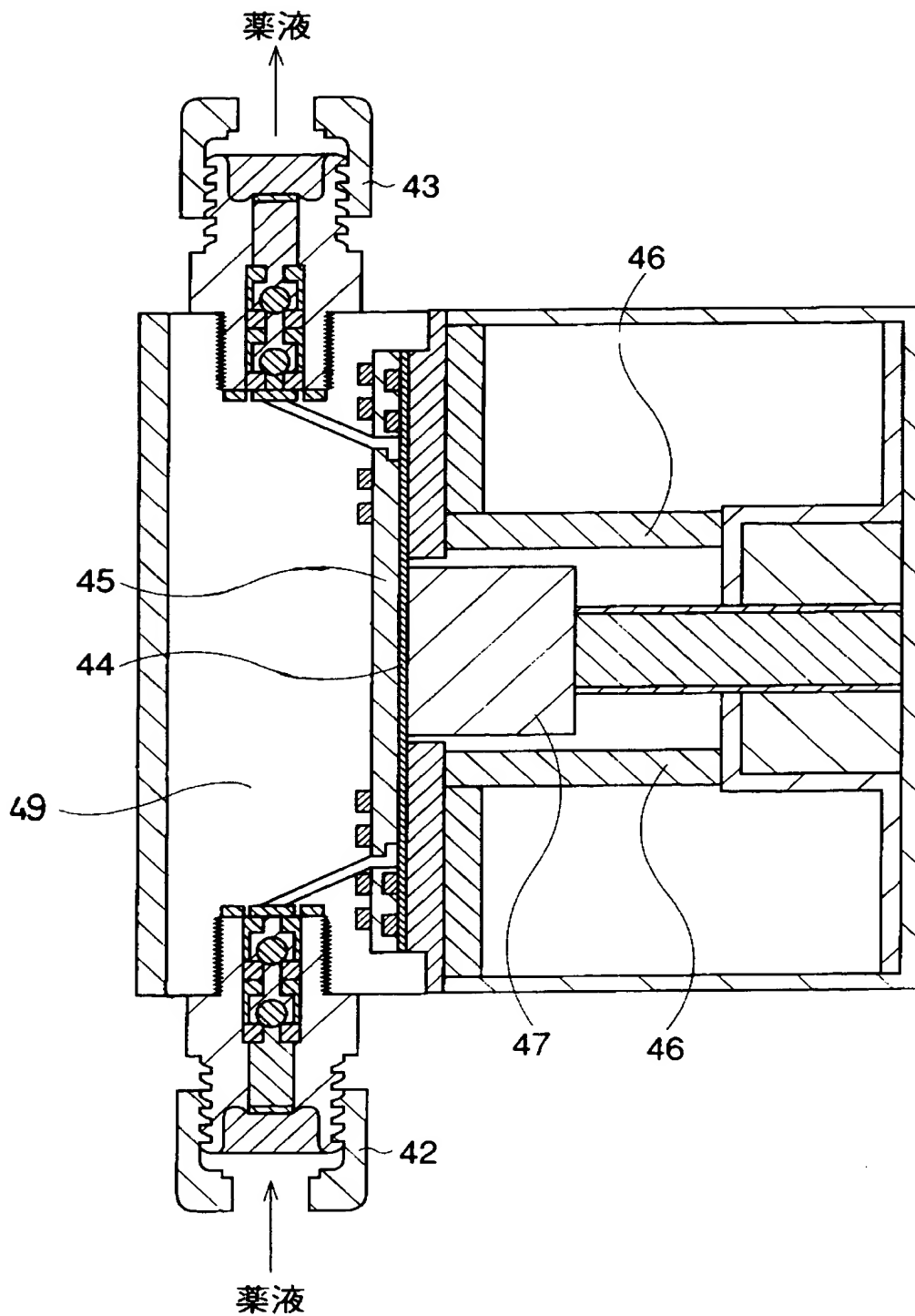
【図 2】



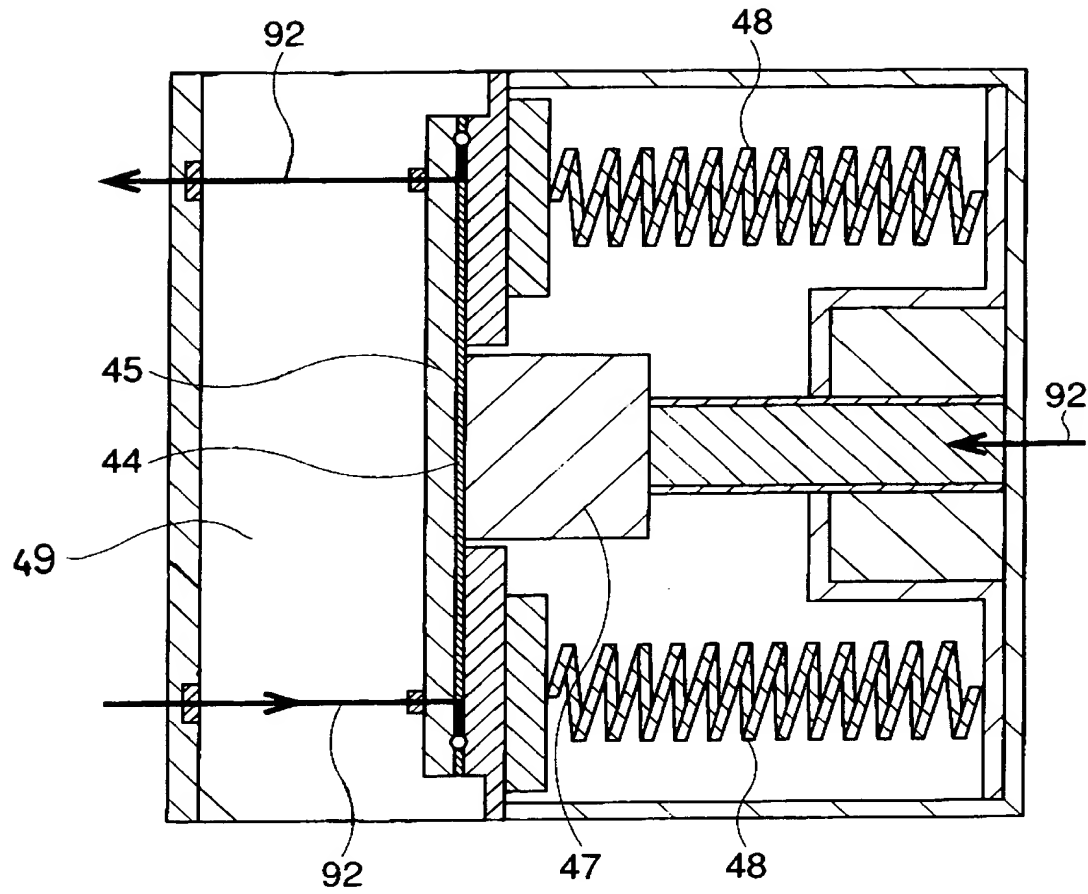
【図 3】



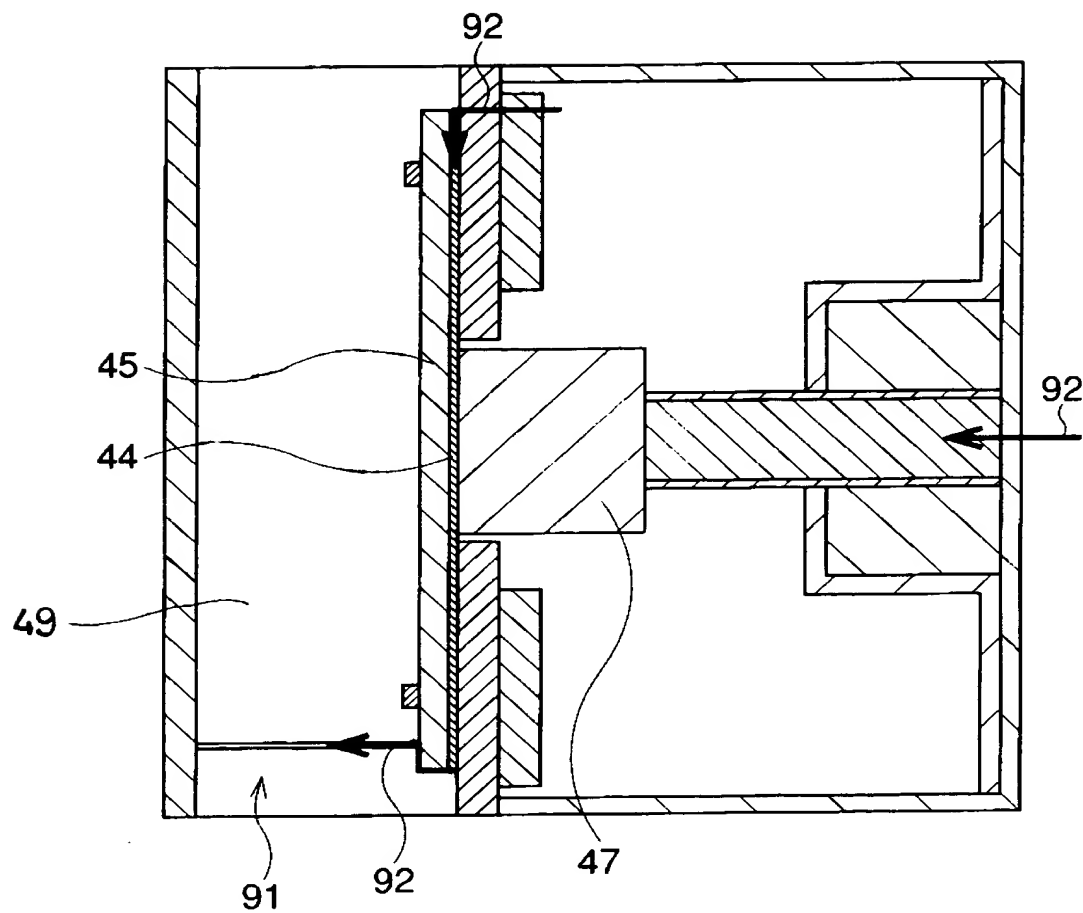
【図4】



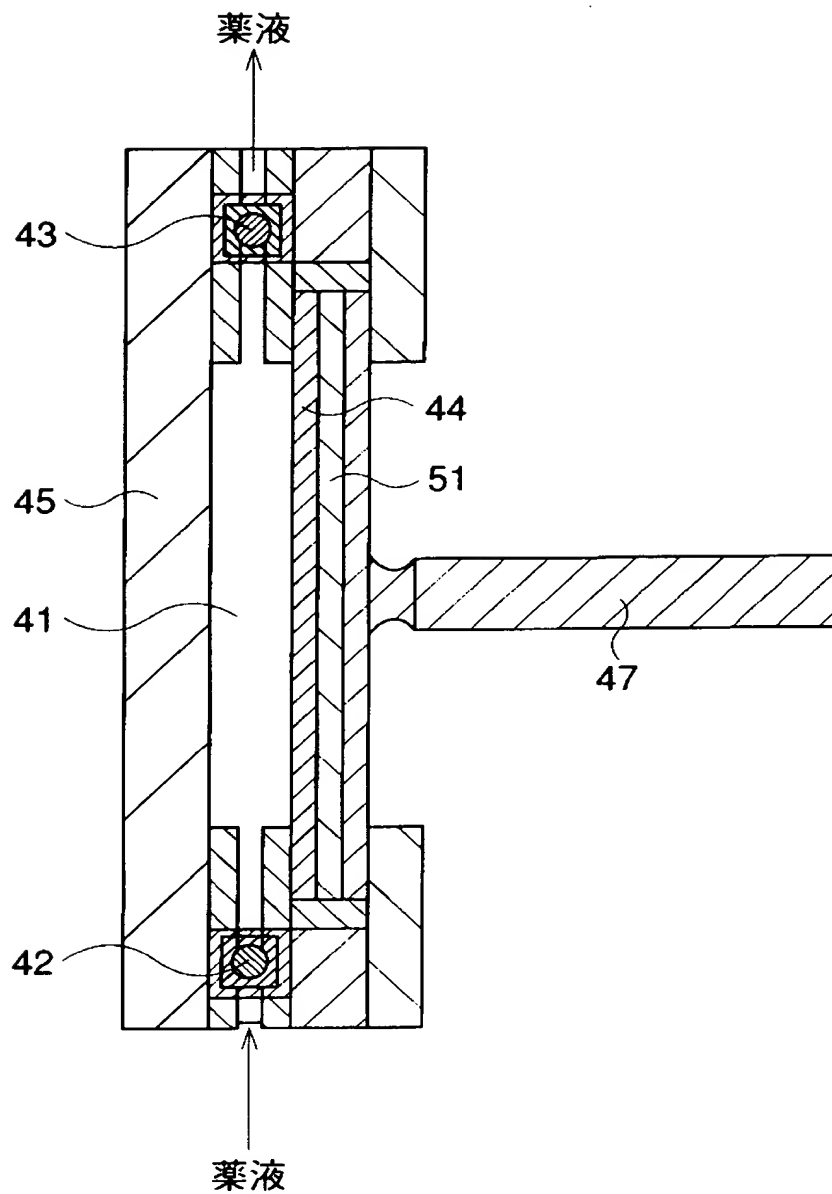
【図 5】



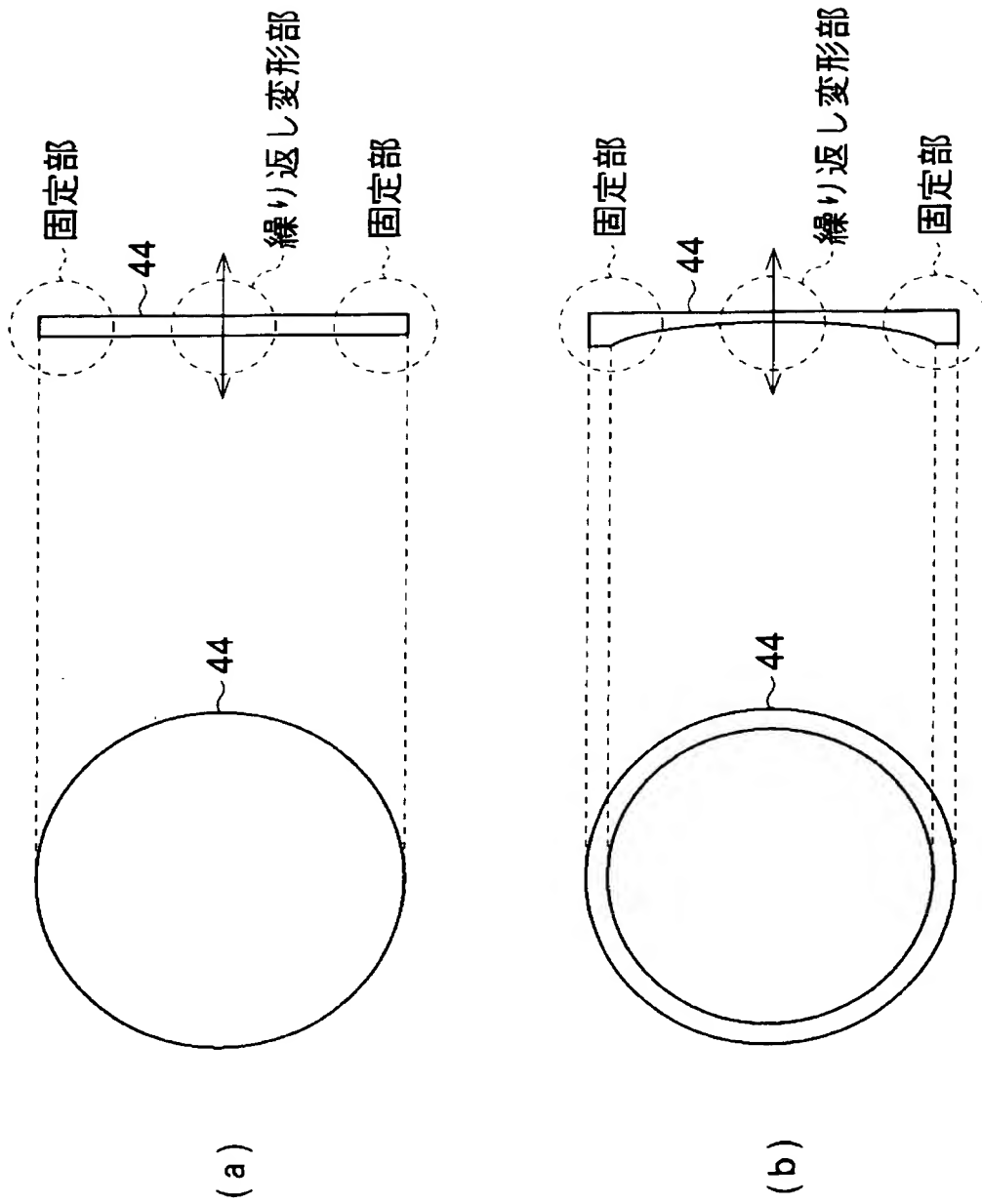
【図6】



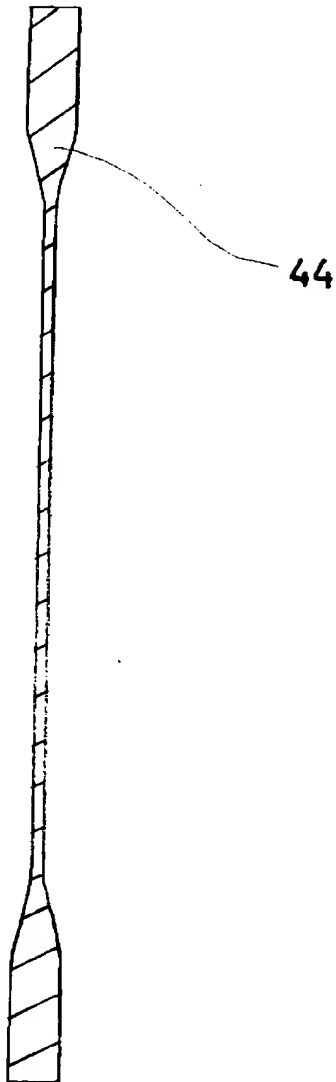
【図 7】



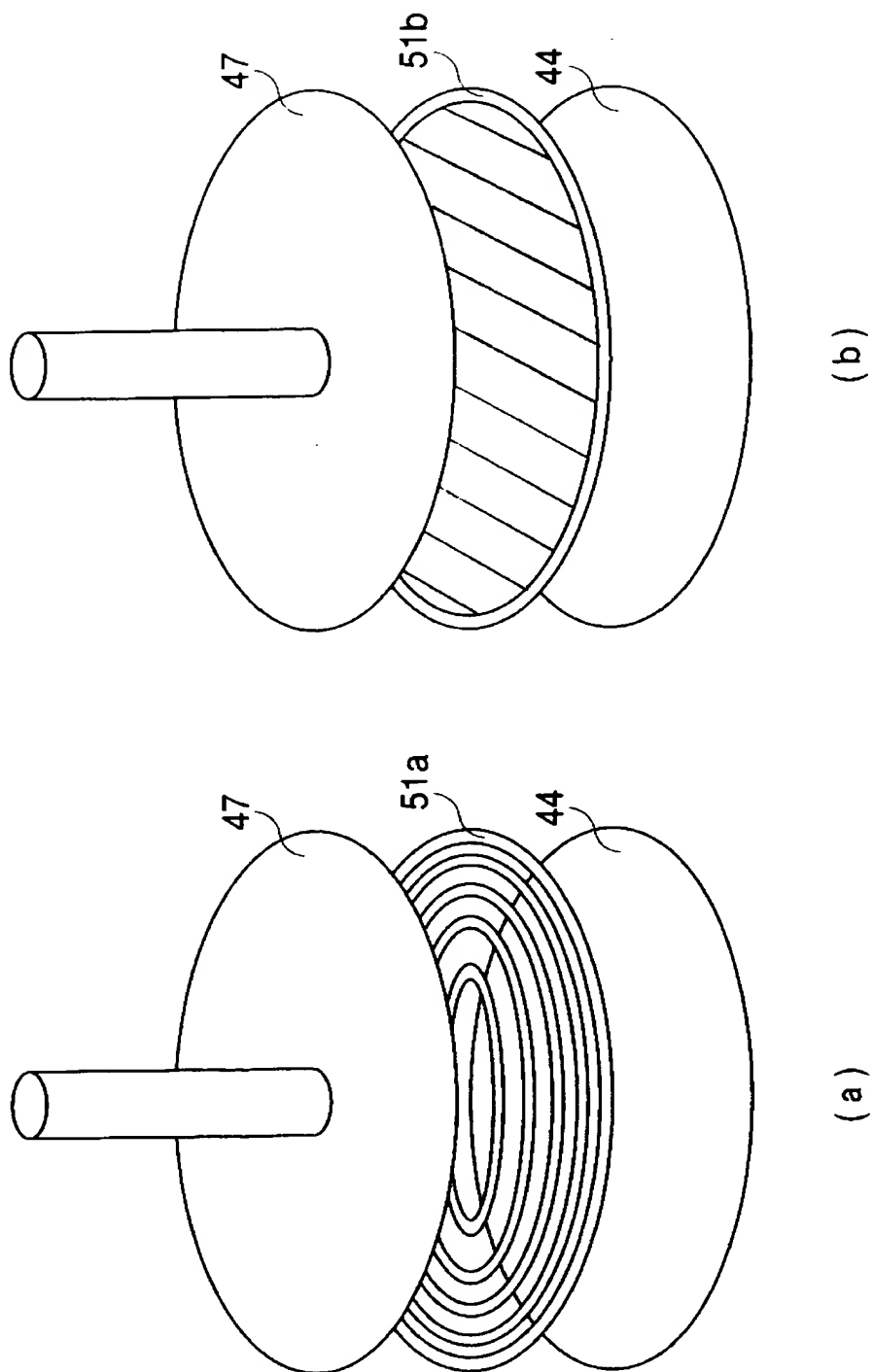
【図8】



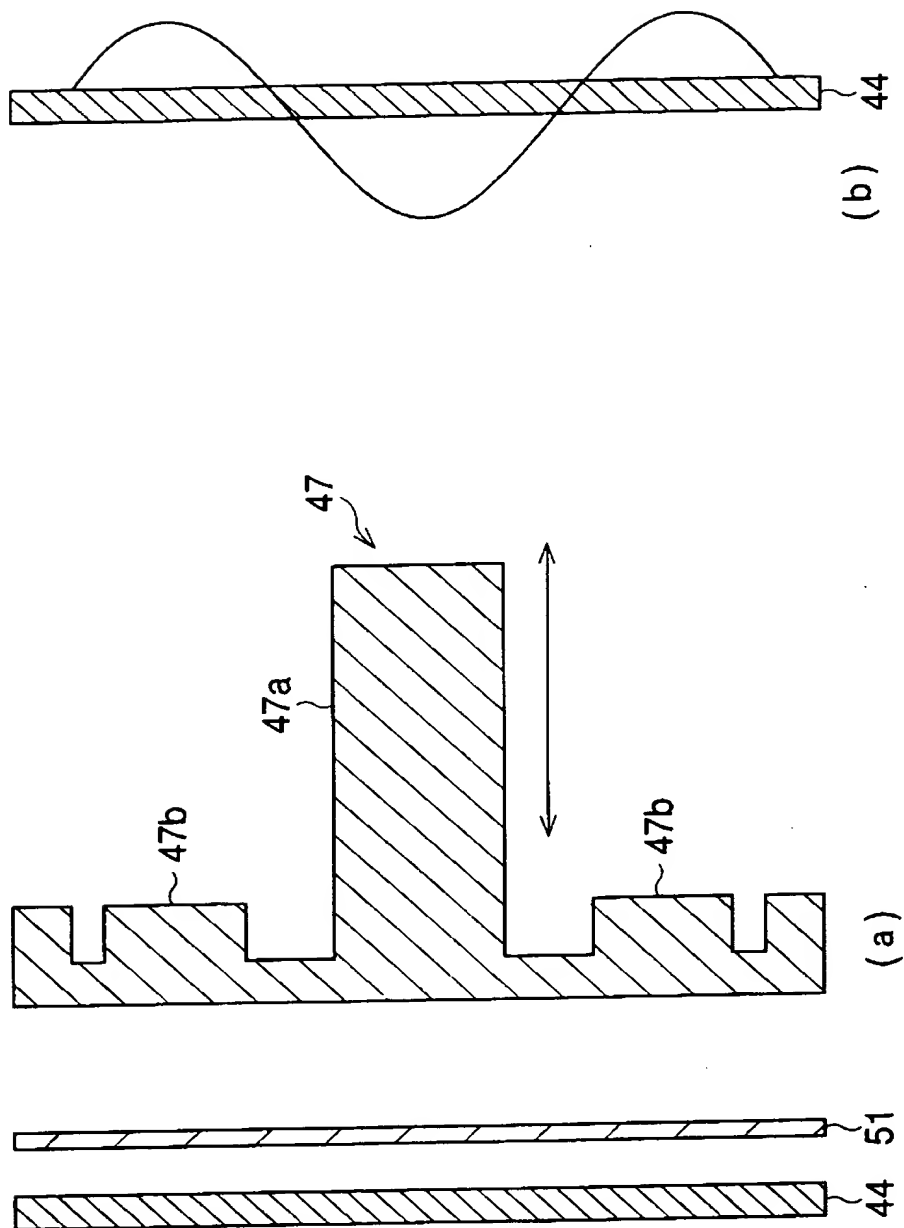
【図 9】



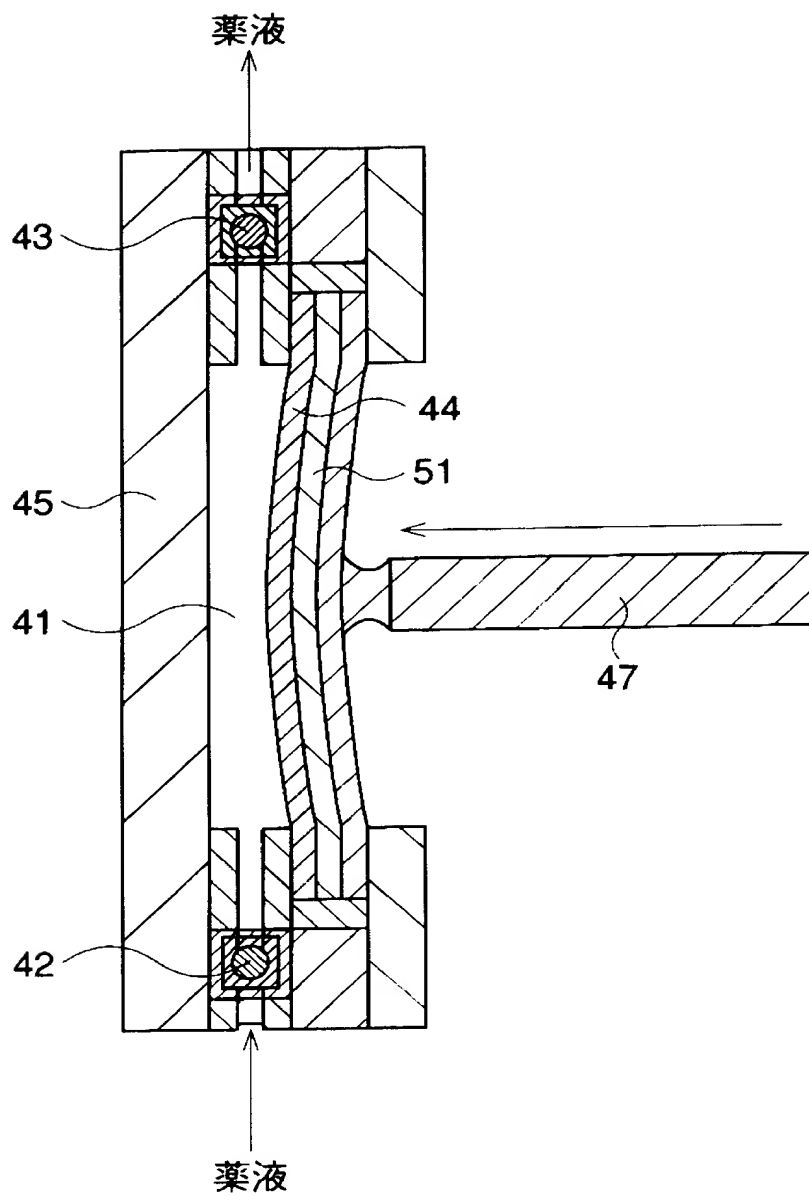
【図 10】



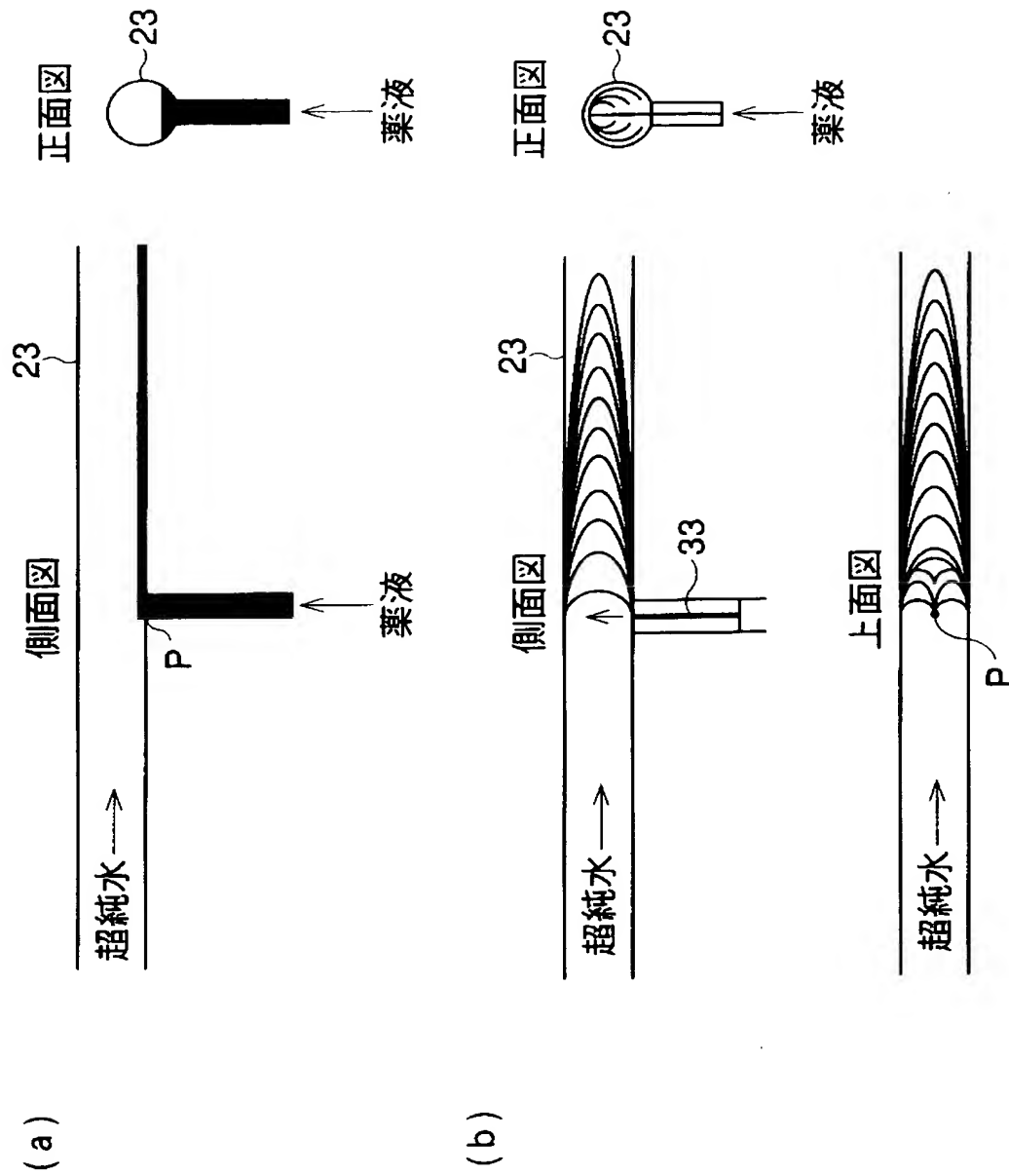
【図 11】



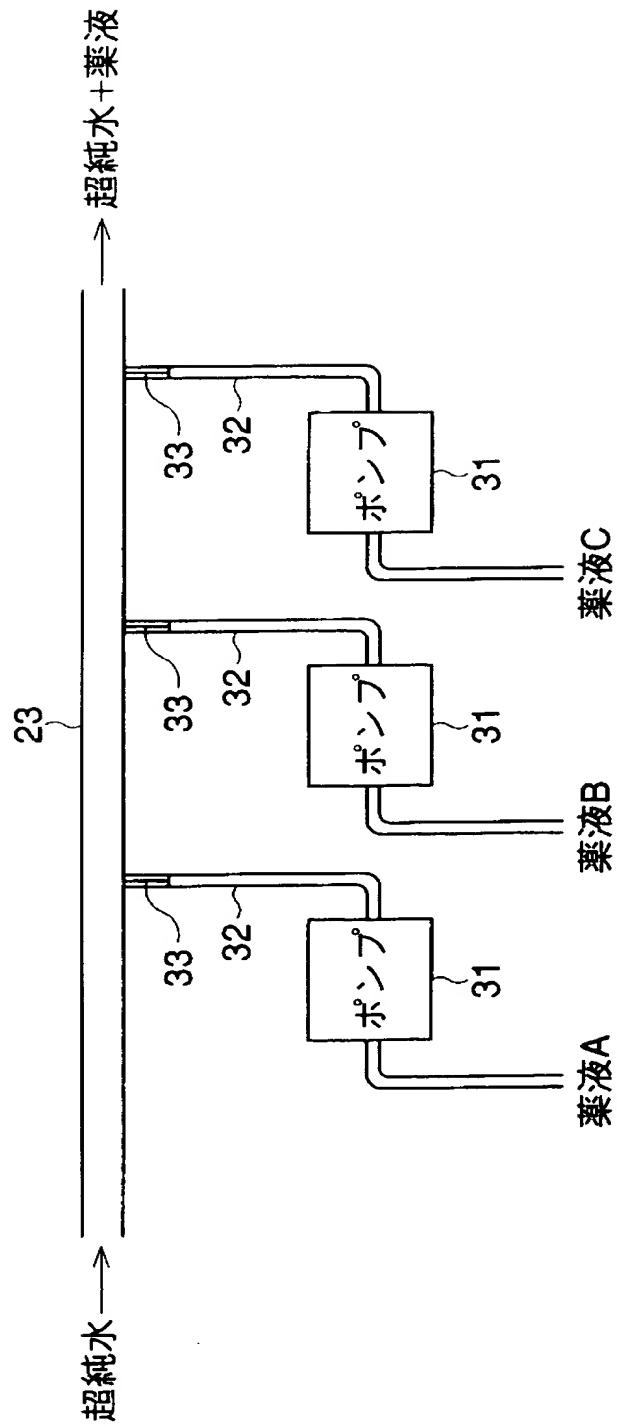
【図 1 2】



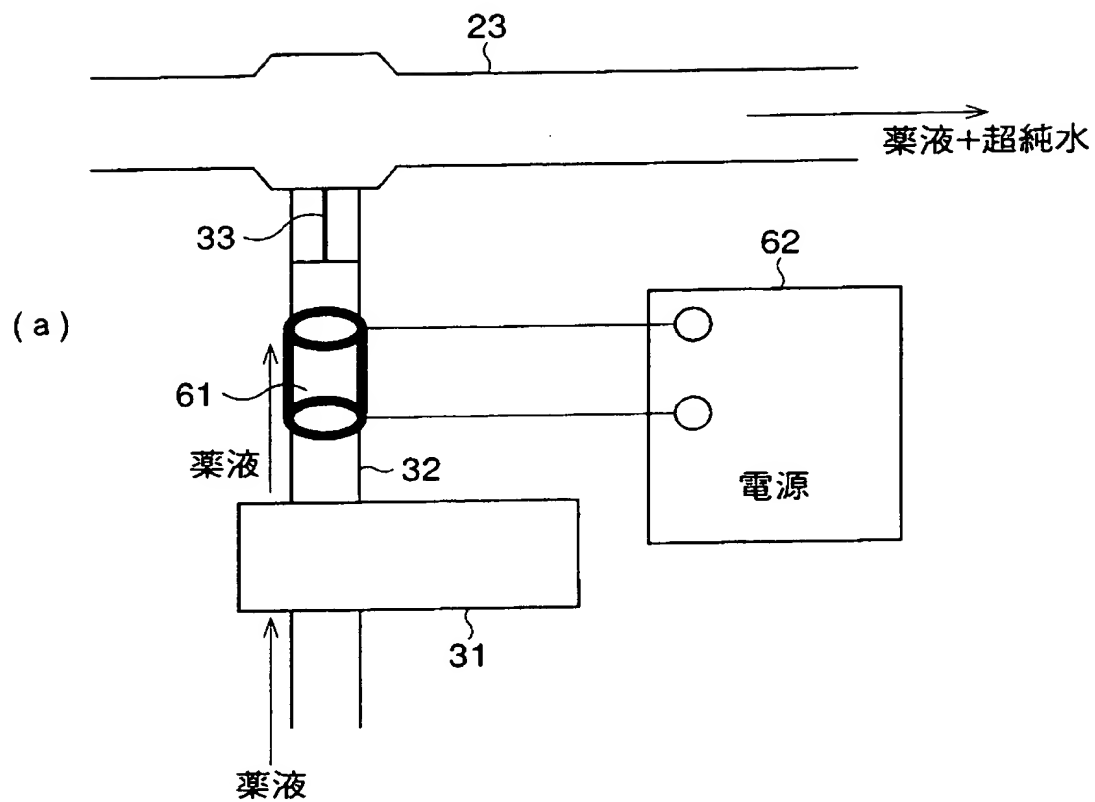
【図 13】



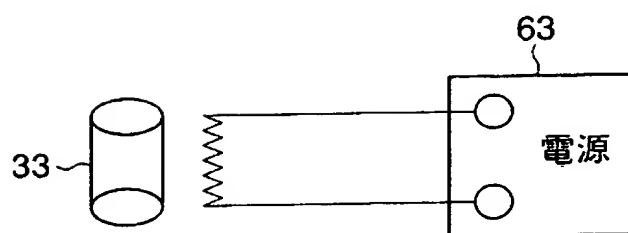
【図 14】



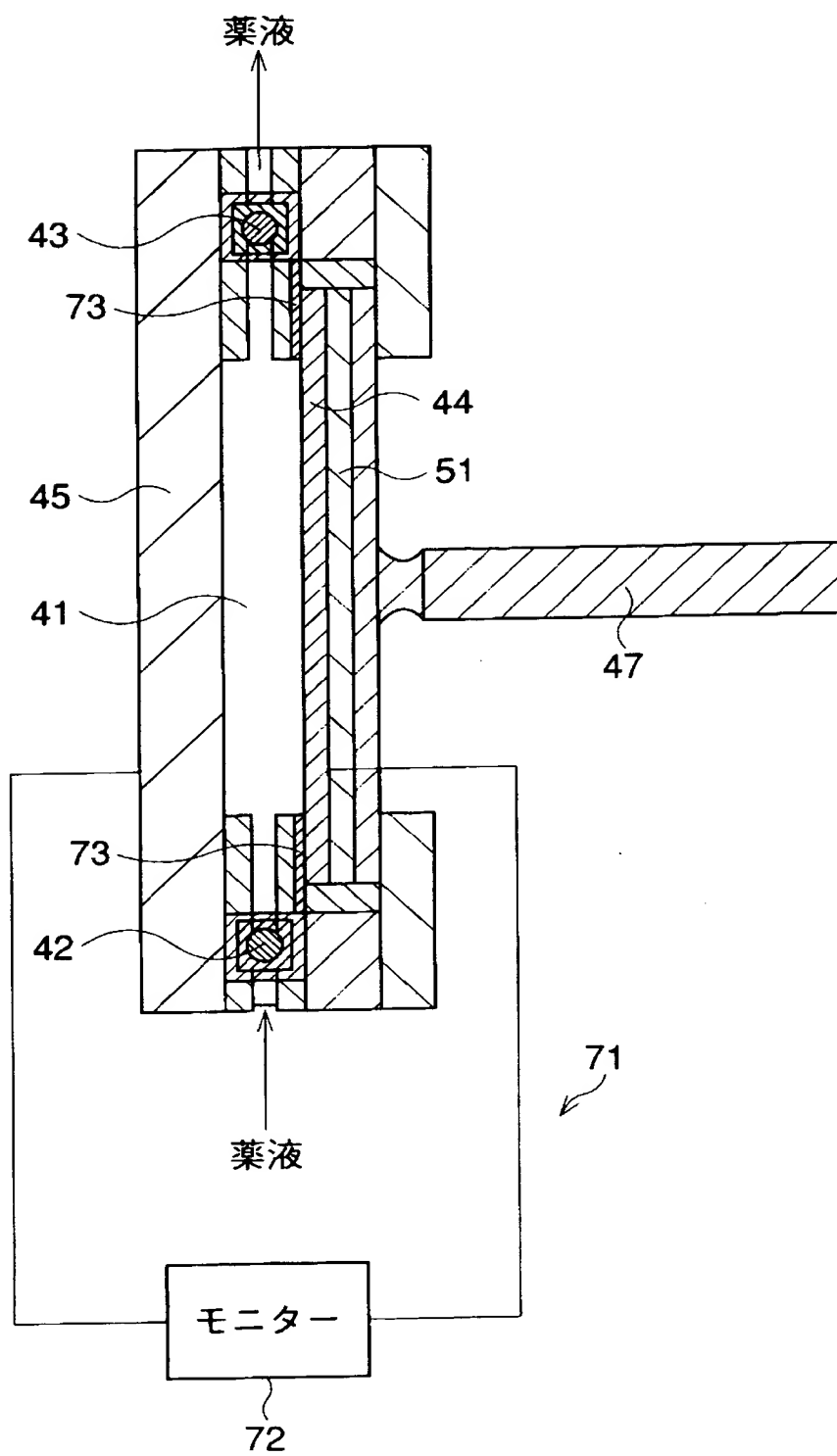
【図15】



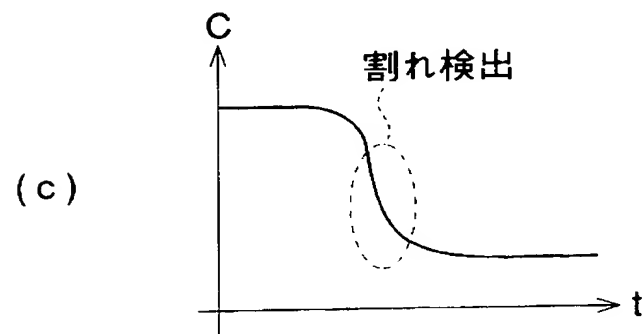
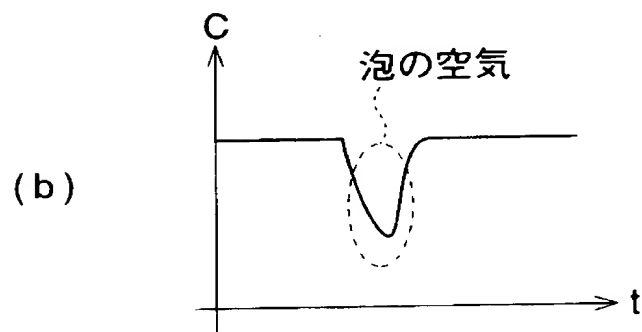
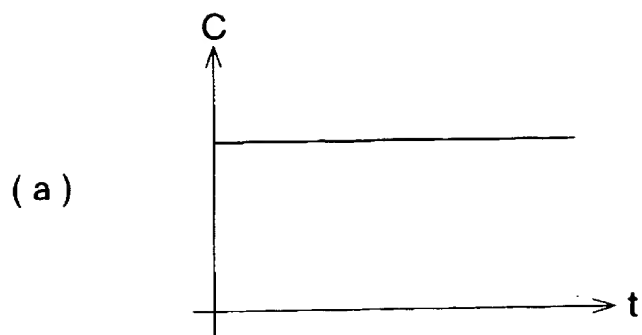
【図16】



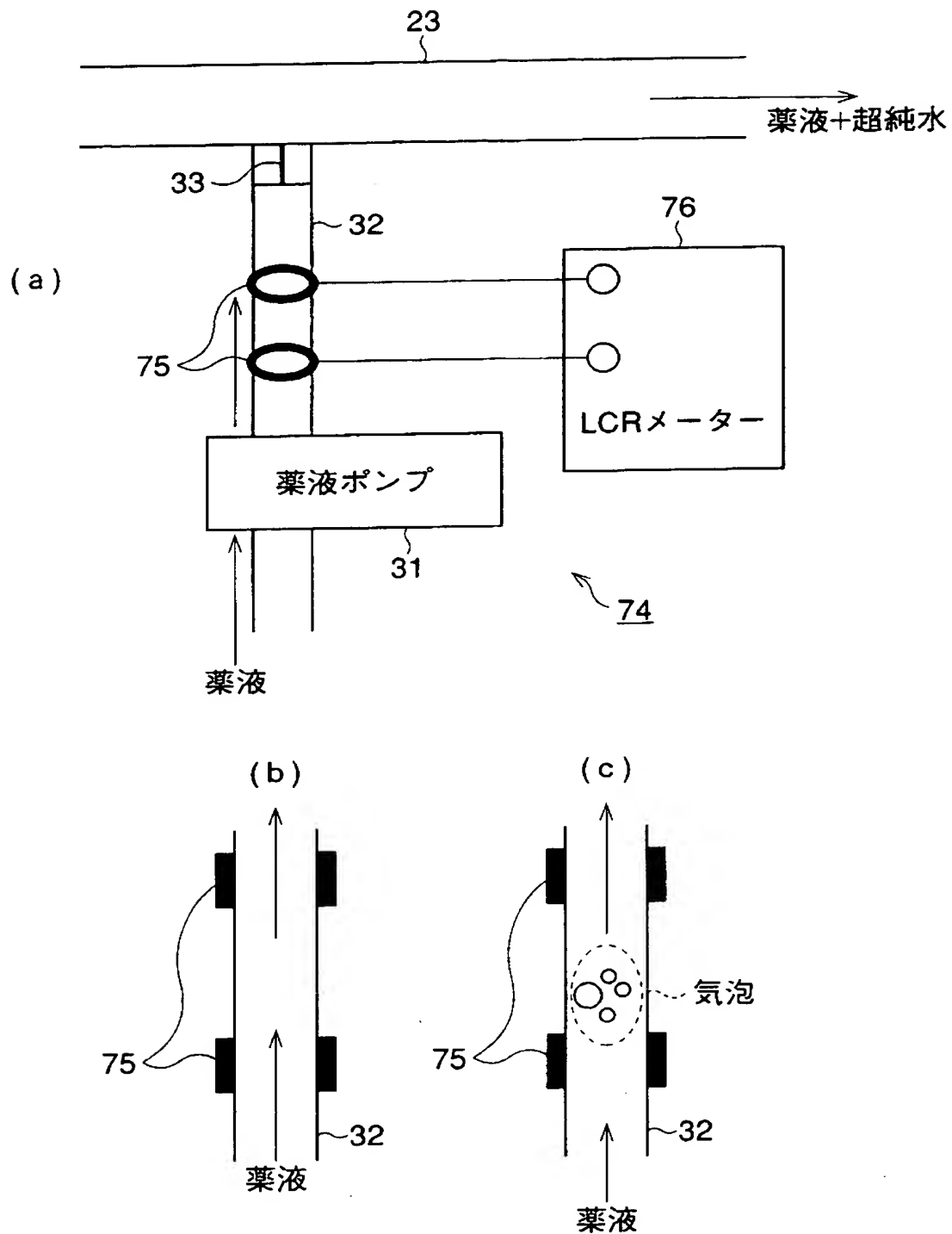
【図17】



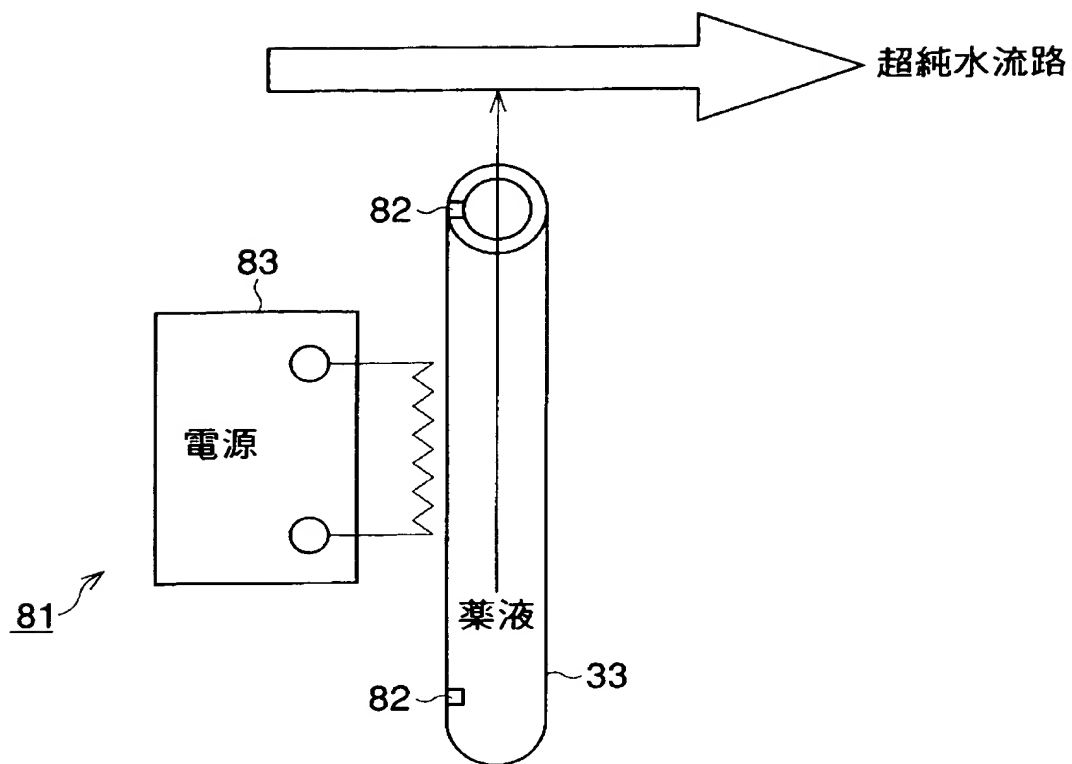
【図 18】



【図19】



【図 20】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 薬液タンクを含む洗浄液供給系の大幅な小型化・簡易化を図るとともに、正確な薬液濃度の洗浄液を簡易且つ迅速に調合し供給することを可能とし、パーティクル等の発生及び洗浄液への混入を極限まで抑止する。

【解決手段】 薬液供給システム 2 を、洗浄用の薬液が原液の状態で貯蔵される薬液貯蔵タンク 21 と、薬液貯蔵タンク 21 と連結され薬液供給を能動的に行なう薬液供給装置 22 と、薬液供給装置 22 と連結され、薬液が混合する超純水の通路となる供給流路を形成する配管系 23 と、洗浄チャンバー 1 内で設置されるウェハ 11 の各表面と対向するように配管系 23 の端部に設けられ、前記各表面に洗浄液を供給する一対の吐出ノズル 24, 25 とを主要素として構成する。

【選択図】 図 1

【書類名】 職権訂正データ
【訂正書類】 特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】
【識別番号】 596089517
【住所又は居所】 東京都文京区本郷 4 - 1 - 4
【氏名又は名称】 株式会社ウルトラクリーンテクノロジー開発研究所
【代理人】 申請人
【識別番号】 100090273
【住所又は居所】 東京都豊島区東池袋 1 丁目 1 7 番 8 号 池袋 T G ホ
ーメストビル 5 階 國分特許事務所
【氏名又は名称】 國分 孝悦

特願平 1 0 - 3 1 9 0 3 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [5 9 6 0 8 9 5 1 7]

1. 変更年月日 1 9 9 6 年 6 月 2 0 日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都文京区本郷 4 - 1 - 4
氏 名 株式会社ウルトラクリーンテクノロジー開発研究所

2. 変更年月日 2 0 0 0 年 6 月 2 0 日
[変更理由] 名称変更
住 所 東京都文京区本郷 4 - 1 - 4
氏 名 ユーシーティー株式会社